

# Физическая электроника

---

# **Электронные процессы в твердом теле**

# **Оптические явления в твердом теле**

Петрова  
Ольга Борисовна

[petrova@proriv.ru](mailto:petrova@proriv.ru)

8-903-201-65-98

# Структура курса

Форма	Количество	Баллы
Лекции	$\sim 16$	--
Лабораторные	<b>5</b>	<b>7 * 5</b>
Контрольные	<b>1</b>	<b>15</b>
Домашние	<b>1</b>	<b>10</b>
Экзамен	<b>1</b>	<b>40</b>

# **Основные направления курса**

- Элементы зонной теории твердых тел
- Полупроводники, генерация и движение носителей тока
- Сверхпроводники
- Диэлектрические материалы
- Магнитные материалы
- Электронные и ионные явления в газах, газовые разряды

# **Основные направления курса**

- Начальные сведения о технике СВЧ
- Фотоэлектрические приборы
- Люминесценция
- Лазеры
- Волоконная оптика
- Новые и перспективные  
направления в электронике

# Элементы зонной теории твердых тел

**Зонная теория базируется на  
принципах квантовой механики:**

- ❖ принцип квантования
- ❖ принцип неопределённости Гейзенберга
- ❖ принцип несовместимости Паули

# **Специфические допущения:**

**1) разделение частиц кристалла на лёгкие и тяжёлые - на валентные электроны и ионы.**

# Специфические допущения:

В равновесии,

$$W_e = W_i$$

$$\frac{m_e \cdot V_e^2}{2} = \frac{M_i \cdot V_i^2}{2} \quad \frac{V_e^2}{V_i^2} = \frac{M_i}{m_e}$$

$$M_i \approx 1800 m_e$$

$$\frac{V_e}{V_i} = \sqrt{\frac{M_i}{m_e}} = \sqrt{1800} \approx 40$$

# **Специфические допущения:**

**1) разделение частиц кристалла на лёгкие и тяжёлые - на валентные электроны и ионы.**

=> **не рассматриваем:** обмен энергиями движения ионов и электронов

=> система электронов **изолированная**

**«адиабатическое приближение»**

# Специфические допущения:

2 ) пренебрежение всеми процессами в кристаллах, сопровождающимися конечным смещением ионов

=> не рассматриваем:

- ✓ фазовые превращения,
- ✓ процессы с изменением ионной конфигурации

# Специфические допущения:

3 ) сведение задачи многих тел к  
одноэлектронной задаче.

Взаимодействие каждого электрона со всеми  
остальными заменяется действием  
*стационарного поля*, созданного ансамблем  
электронов, на единичный, *выбранный для  
рассмотрения*, электрон.

# **Специфические допущения:**

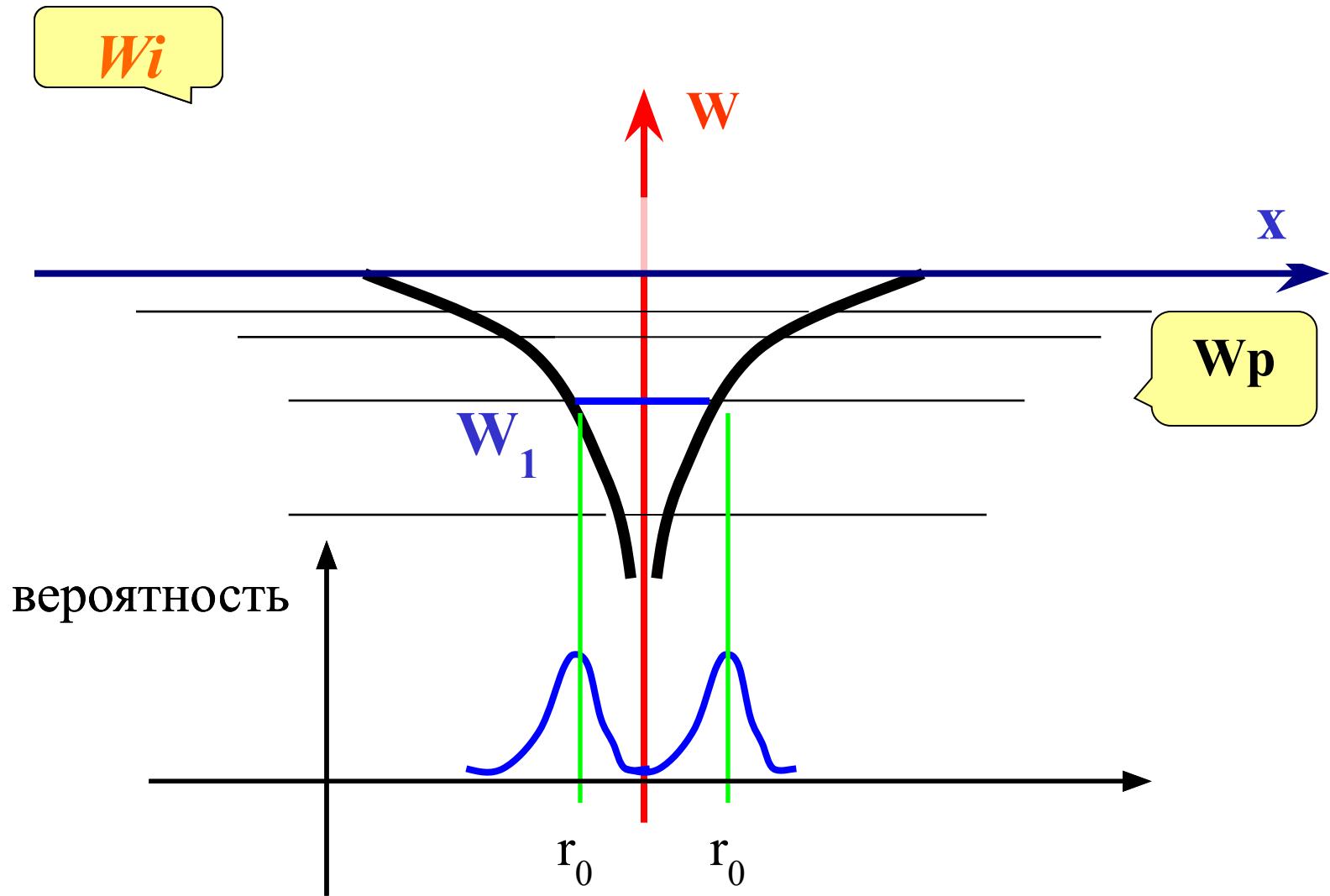
**3 ) сведение задачи многих тел к  
одноэлектронной задаче.**

Решение для газов было выполнено Хартри.

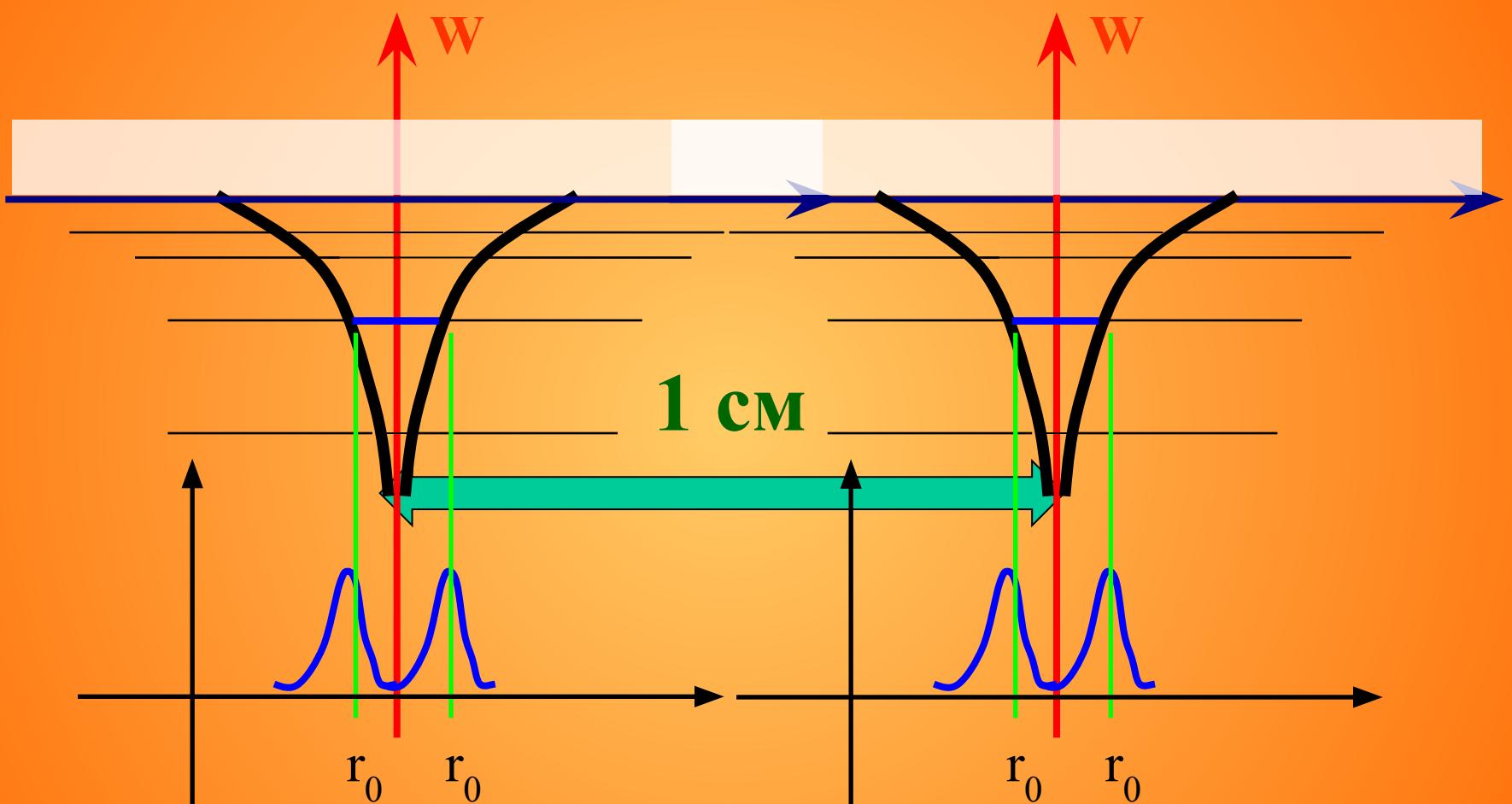
При этом использовалось распределение Максвелла.

Уточнения в уравнения Хартри, налагаемые статистикой Ферми, были внесены Фоком.

# Образование зон

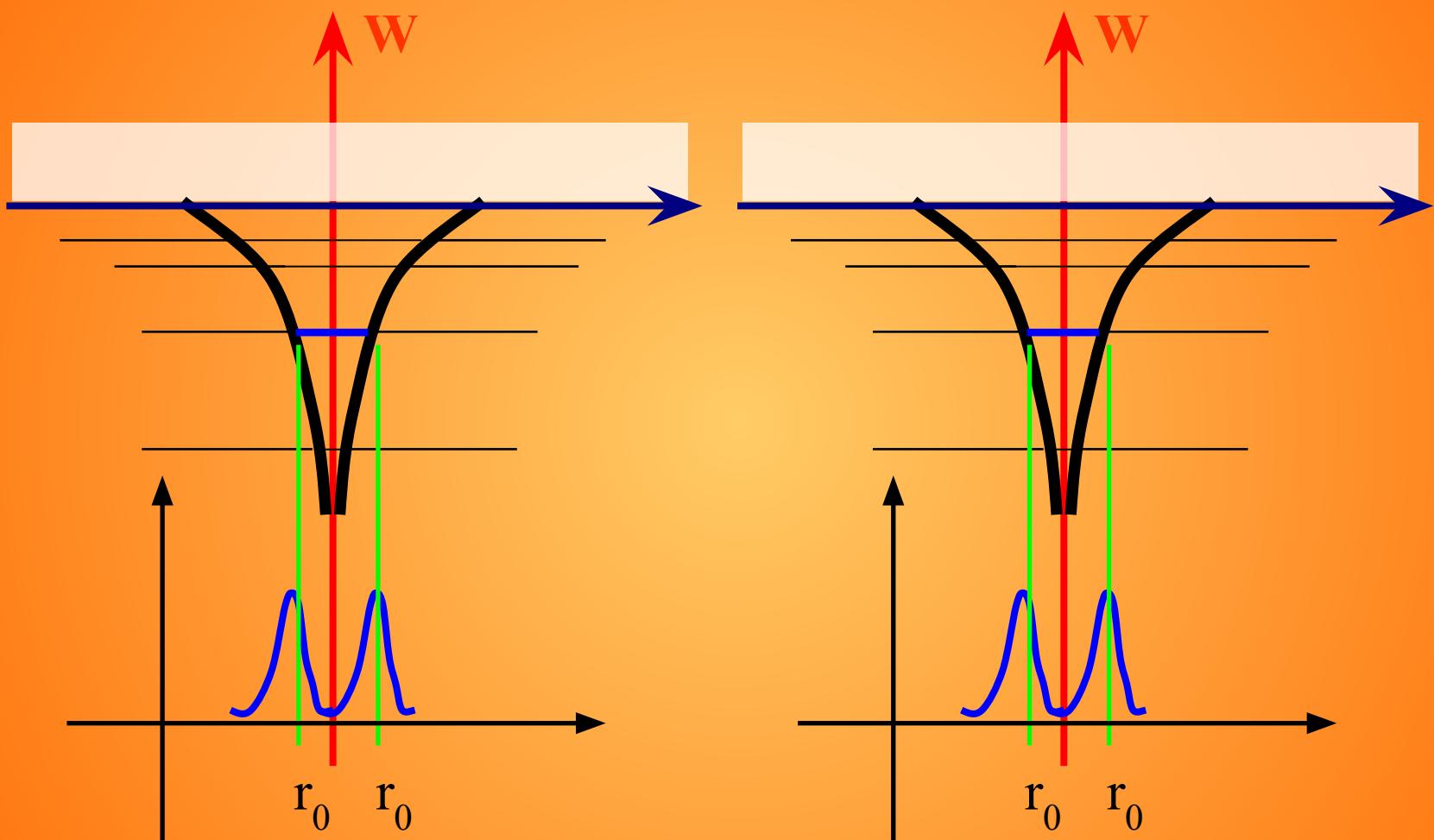


# Образование зон

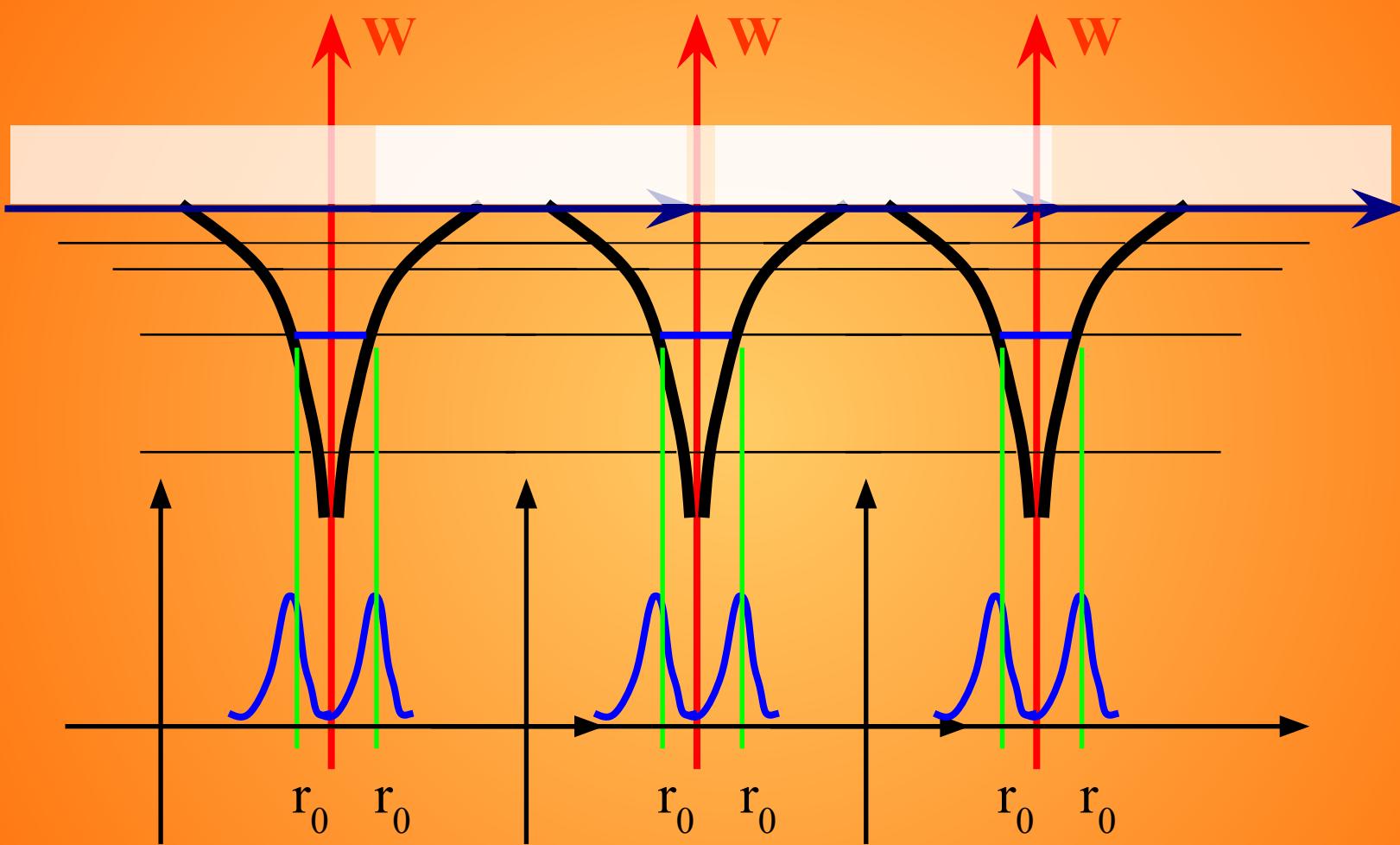


10 100 000 000 лет

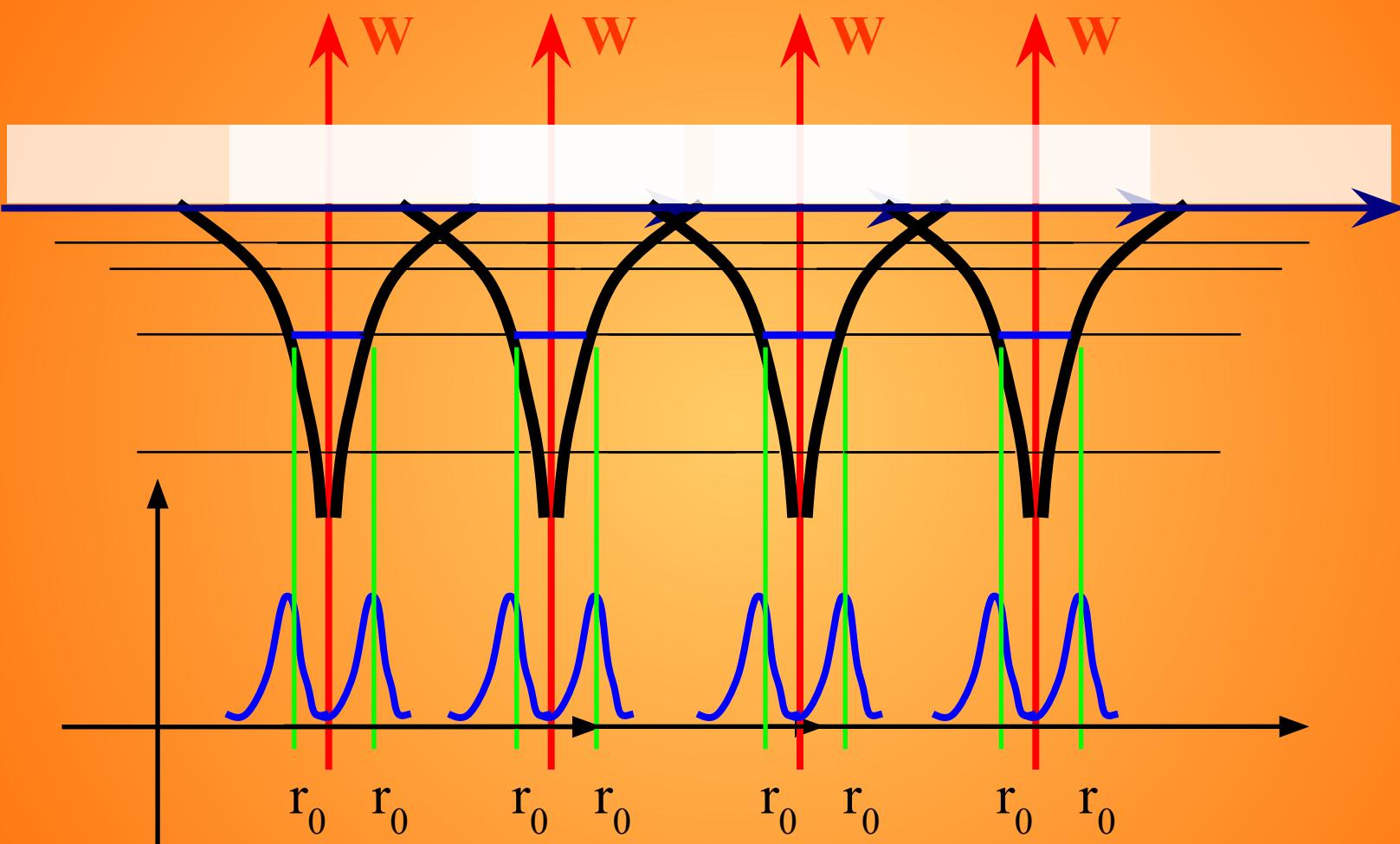
# Образование зон



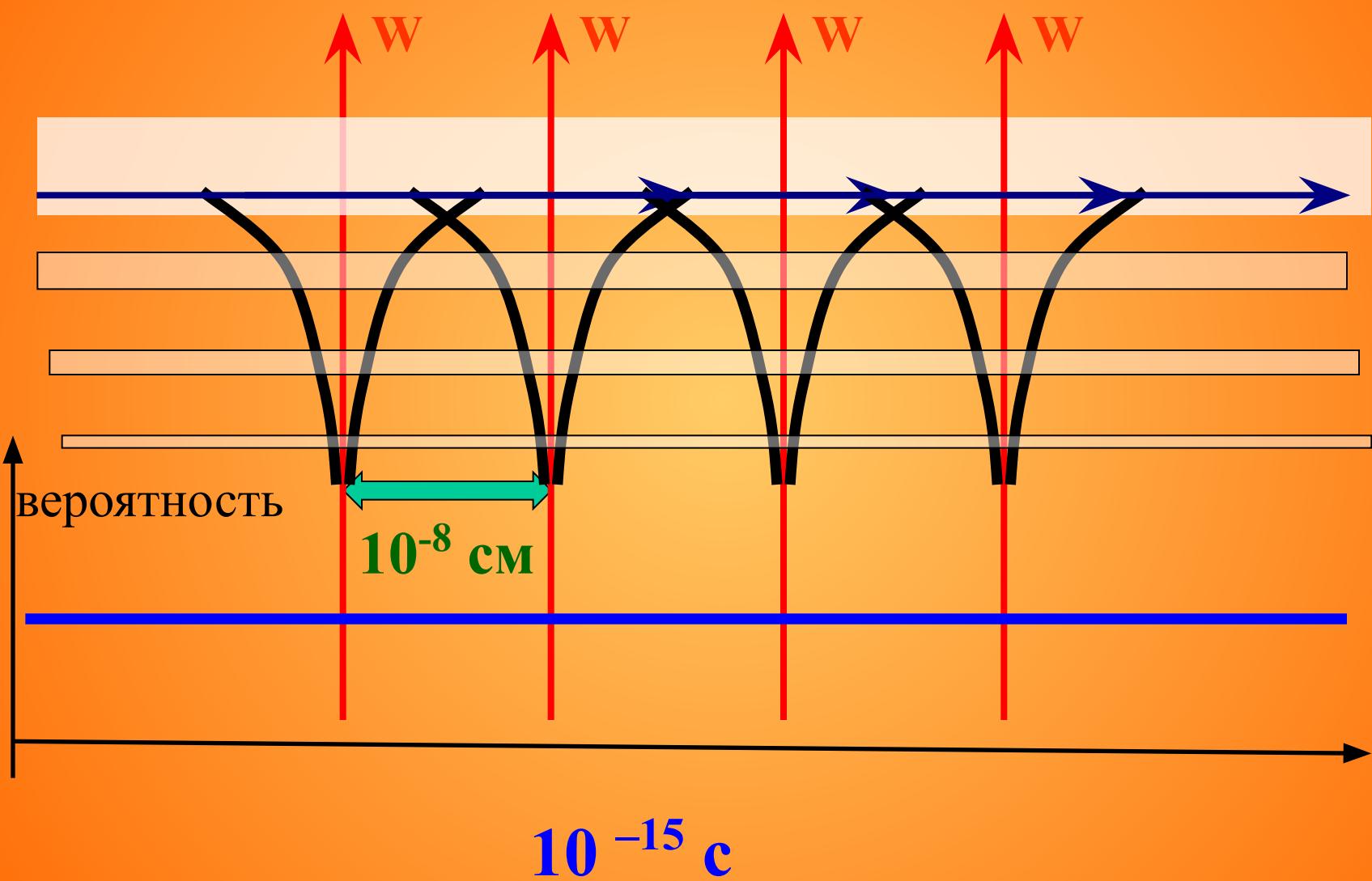
# Образование зон



# Образование зон



# Образование зон



# Образование зон

Расщепление уровней обусловлено принципом неопределённости Гейзенберга:

$$\Delta W \cdot \tau \geq \hbar$$

время возбужденного состояния электрона в отдельном атоме

$$10^{-8} \text{ с}$$

время нахождения валентного электрона около каждого иона в кристалле

$$10^{-15} \text{ с}$$

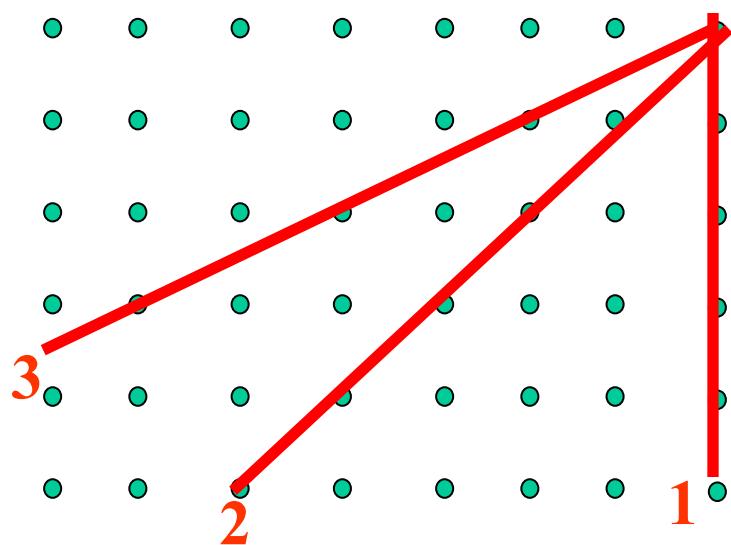
$$\Delta W = \hbar / \tau \quad (\hbar = 6,583 \cdot 10^{-16} \text{ эВ} \cdot \text{с})$$

Уровни в атоме  $\Delta W \sim 10^{-8} \text{ эВ} \cdot \text{с}$

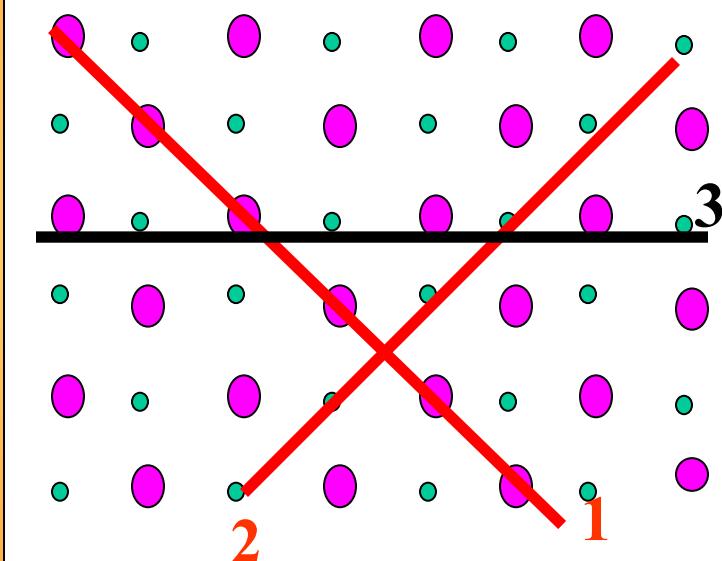
Уровни в кристалле  $\Delta W \sim 1 \text{ эВ} \cdot \text{с}$

# Движение электронов в зонах

Моноатомный кристалл



Бинарный кристалл



# Движение электронов в зонах

масса свободного электрона -  $m$   
эффективная масса -  $m^*$

## Причины изменения $m^*$

1. периодическое электрическое поле решётки
2. вектор силы внешнего поля не обязательно совпадает с направлением разрешённого движения электрона.
3. ширина зоны: более узких зонах обычно и большая величина  $m^*$ .

# Проводимость кристаллов

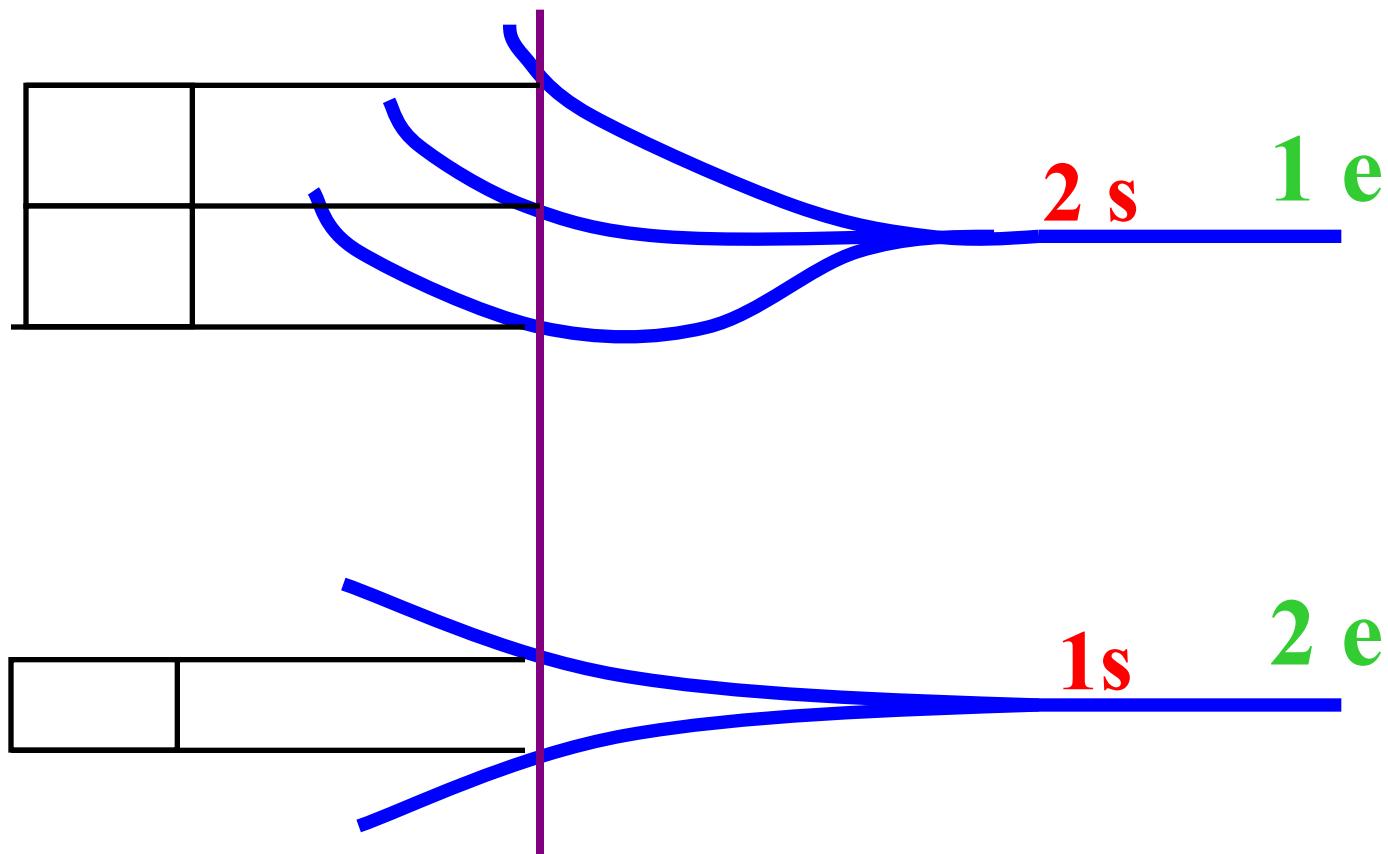
Литий Li  
 $1s^2\ 2s^1$

$2\ s$       1 e  
\_\_\_\_\_

$1s$       2 e  
\_\_\_\_\_

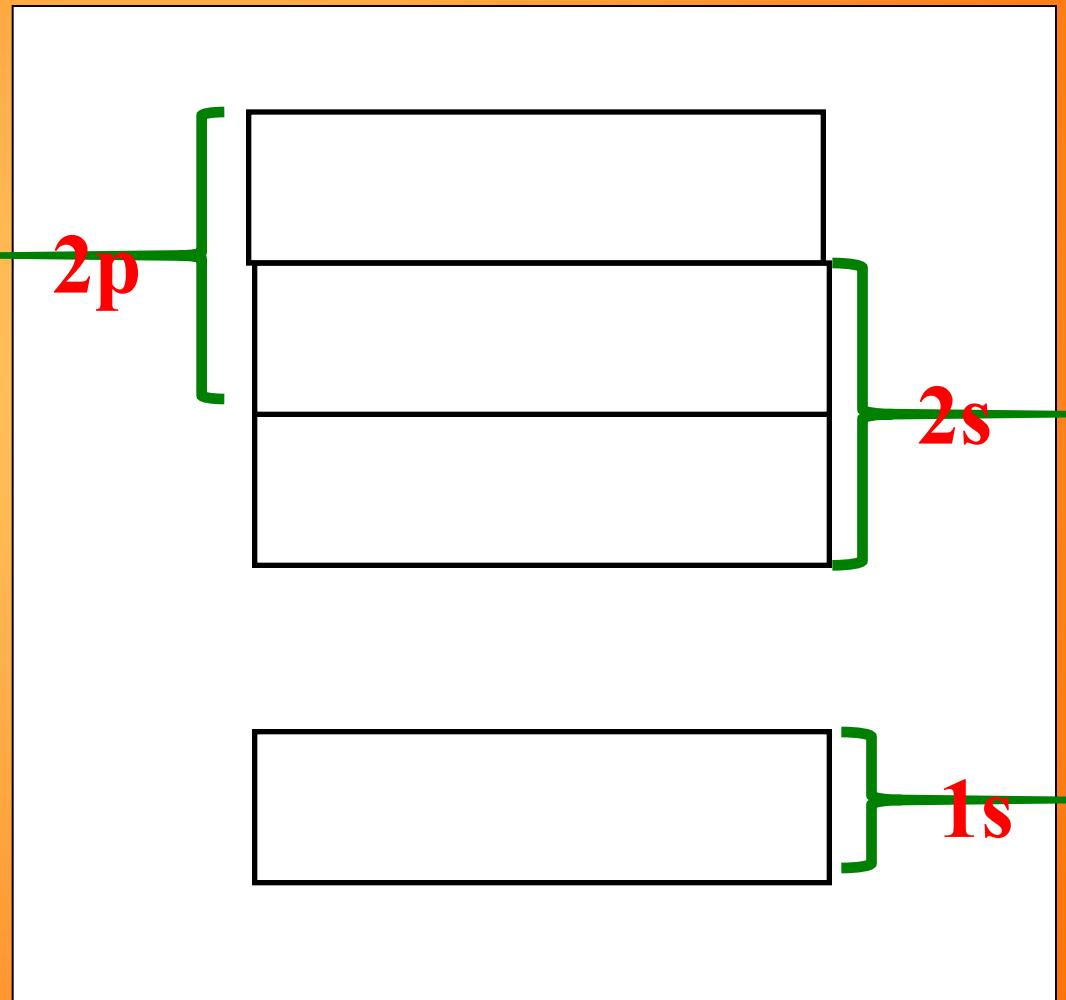
# Проводимость кристаллов

Литий Li  $1s^2 2s^1$



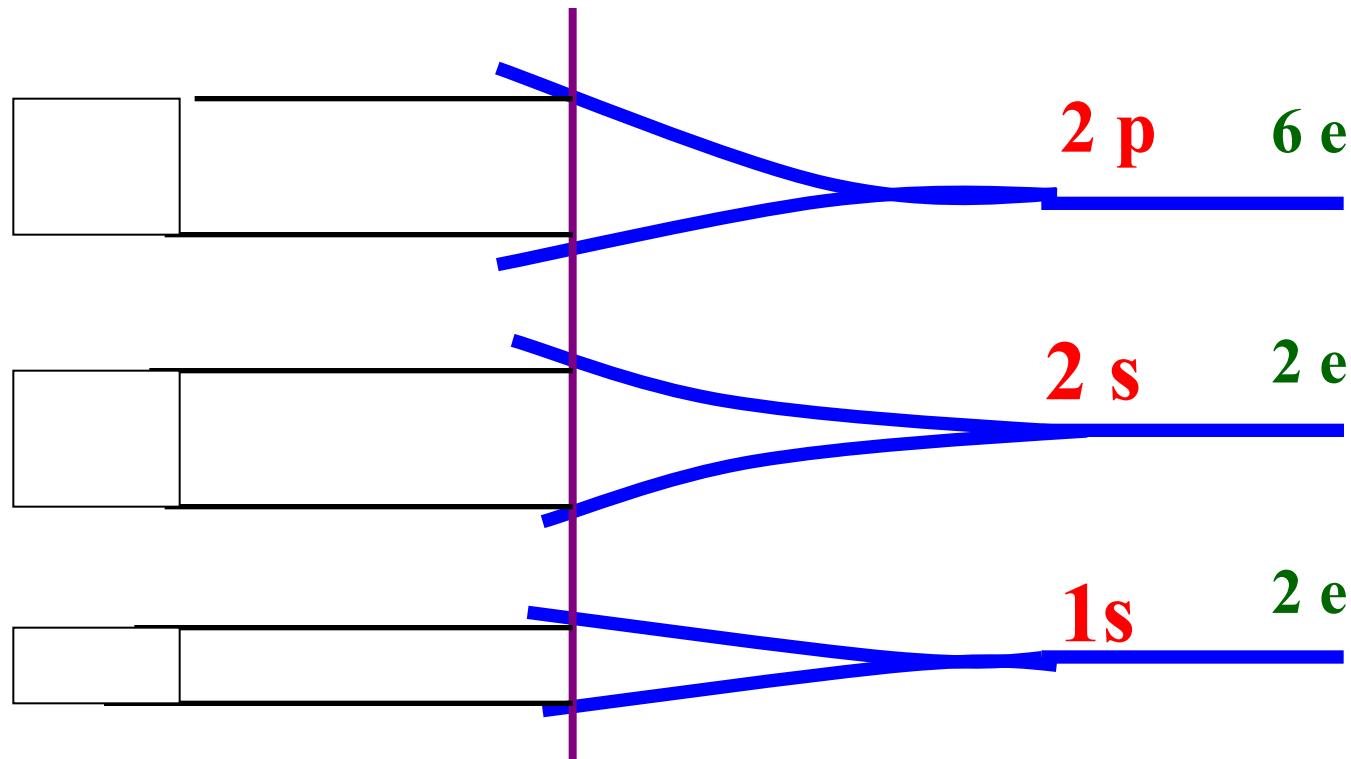
# Проводимость кристаллов

Бериллий Be  
 $1s^2 \ 2s^2$

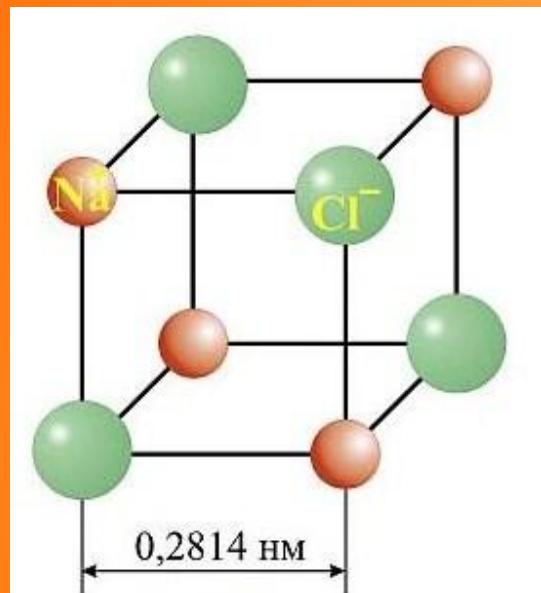


# Проводимость кристаллов

Неон Ne  $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$



# Химический аспект

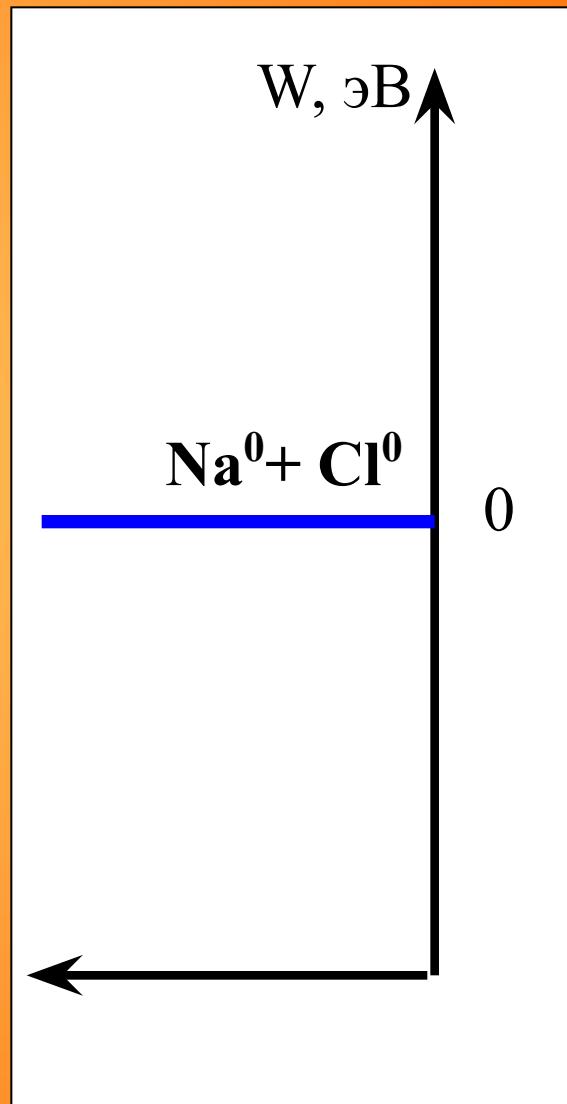


Энергия ионизации  
 $\text{Na} = 5,2 \text{ эВ}$

Сродство к  $e$   
 $\text{Cl} = 3,8 \text{ эВ}$

$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$   
 $\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

$$\text{Na}^0 + \text{Cl}^0 = 0$$



# Химический аспект

$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

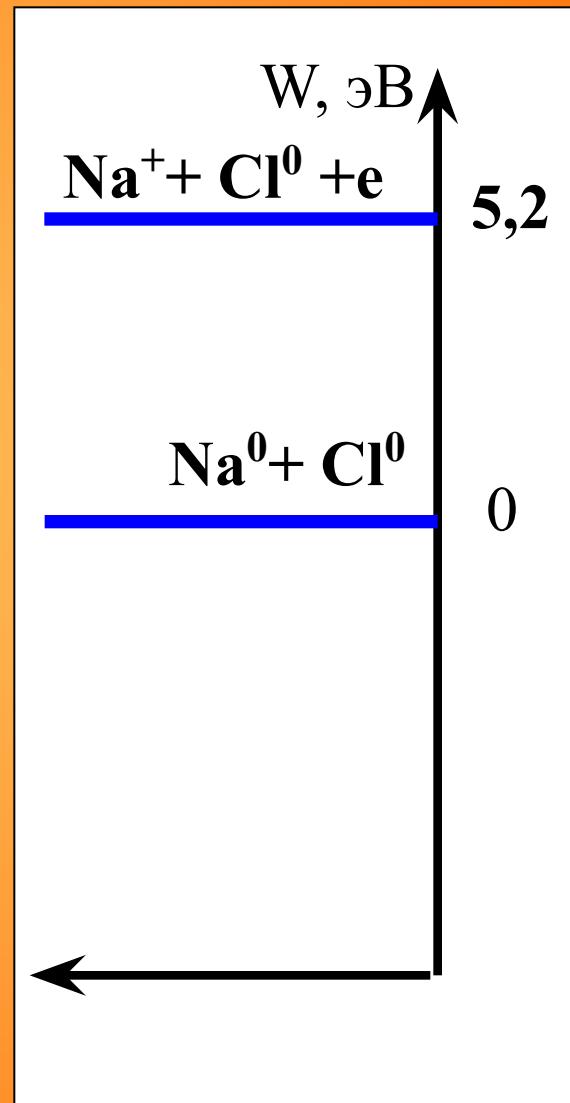
$\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Энергия ионизации  $\text{Na} = 5,2 \text{ эВ}$

Сродство к  $e^- \text{ Cl} = 3,8 \text{ эВ}$

$\text{Na}^0 + \text{Cl}^0 = 0$

$\text{Na}^+ + \text{Cl}^0 + e = 5,2 \text{ эВ}$



# Химический аспект

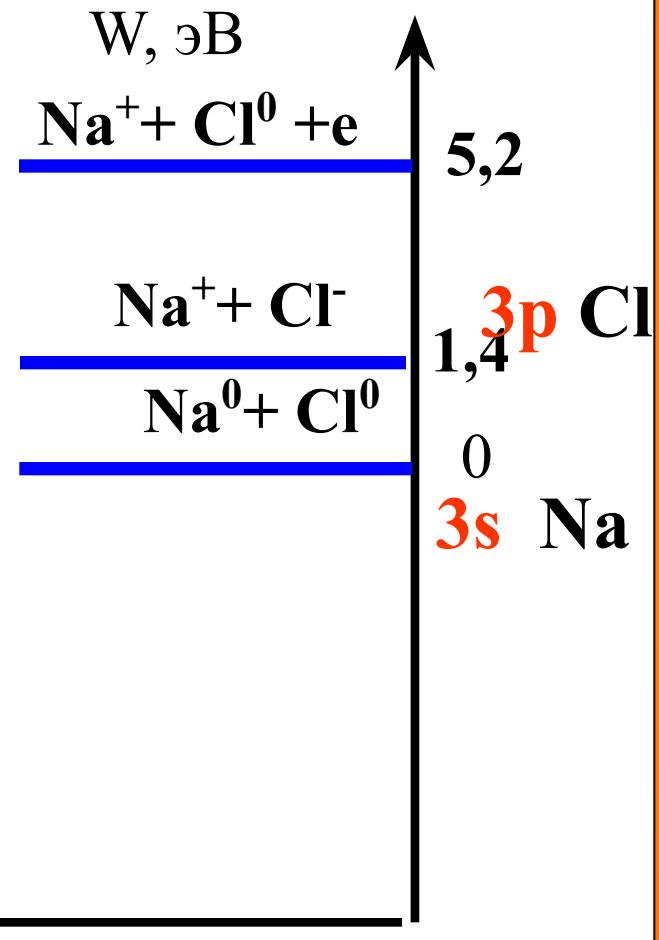
$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

$\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

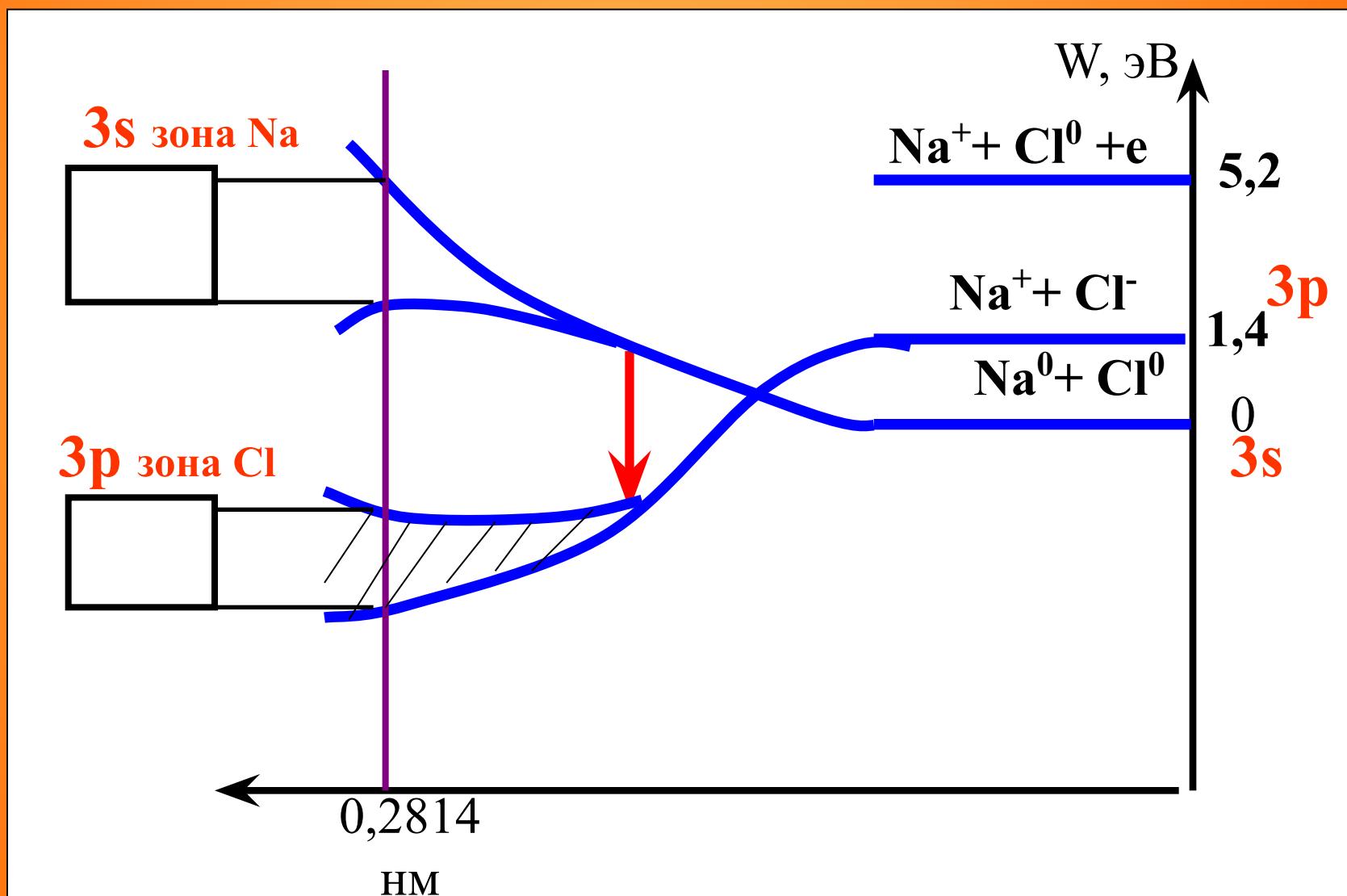
$$\text{Na}^0 + \text{Cl}^0 = 0$$

$$\text{Na}^+ + \text{Cl}^0 + e = 5,2 \text{ эВ}$$

$$\text{Na}^+ + \text{Cl}^- = 1,4 \text{ эВ}$$

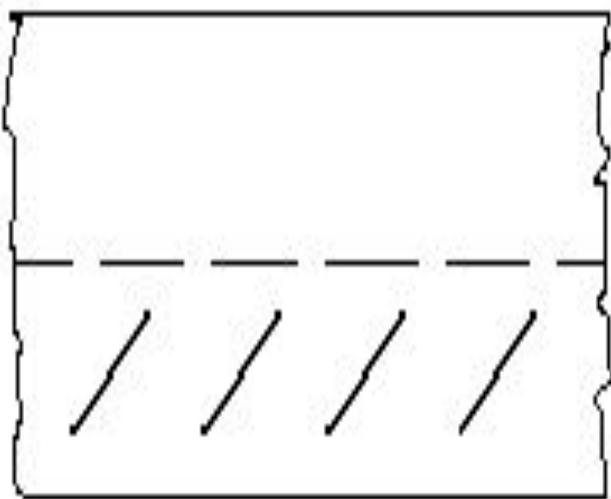


# Химический аспект

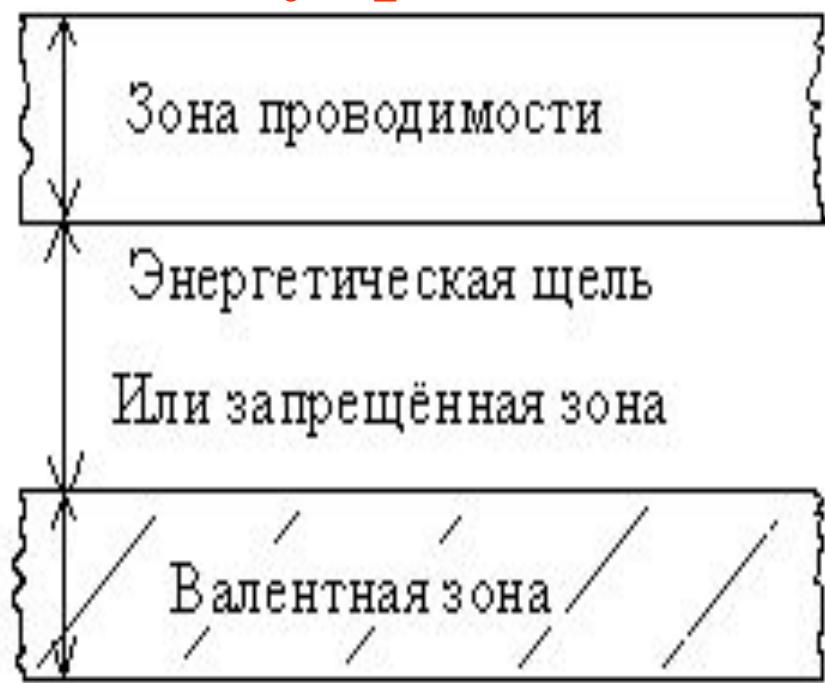


# Проводимость кристаллов

МЕТАЛЛ



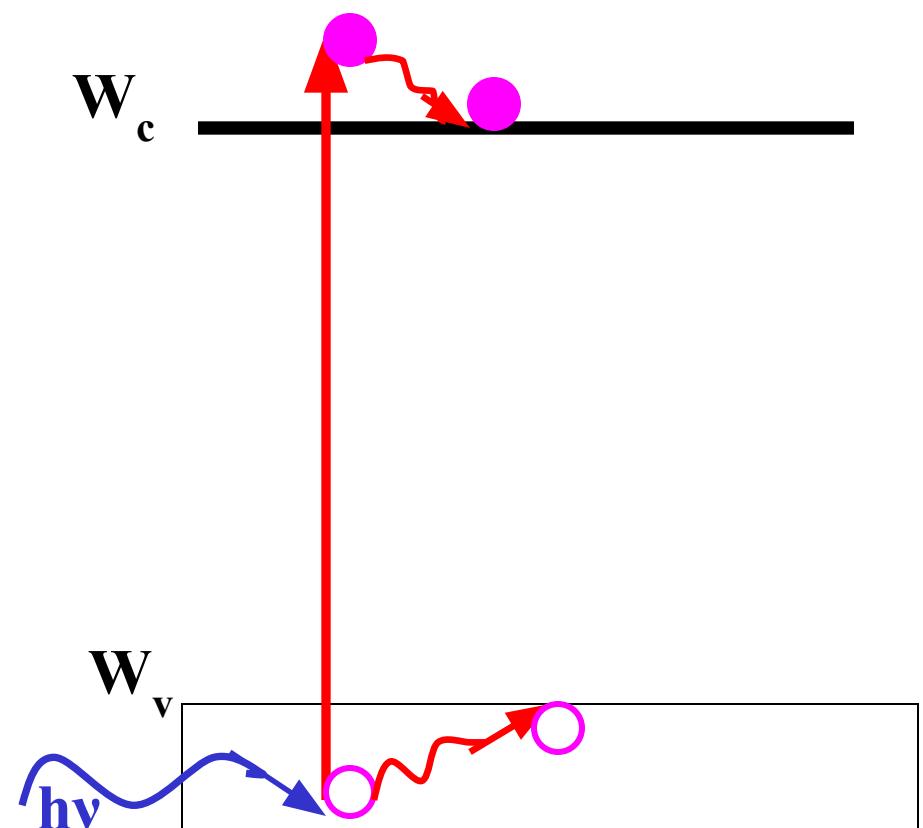
Диэлектрик,  
полупроводник



# Ширина запрещенной зоны

- Германий Ge 0,7 эВ
- Кремний Si 1,1 эВ
- Арсенид галлия AsGa 1,4 эВ
- Сульфид кадмия CdS 2,4 эВ
- Сульфид цинка ZnS 3,7 эВ
- Силленит  $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$  3,25 эВ
- NaCl 8,6 эВ
- алмаз 5,4 эВ

# Проводимость кристаллов

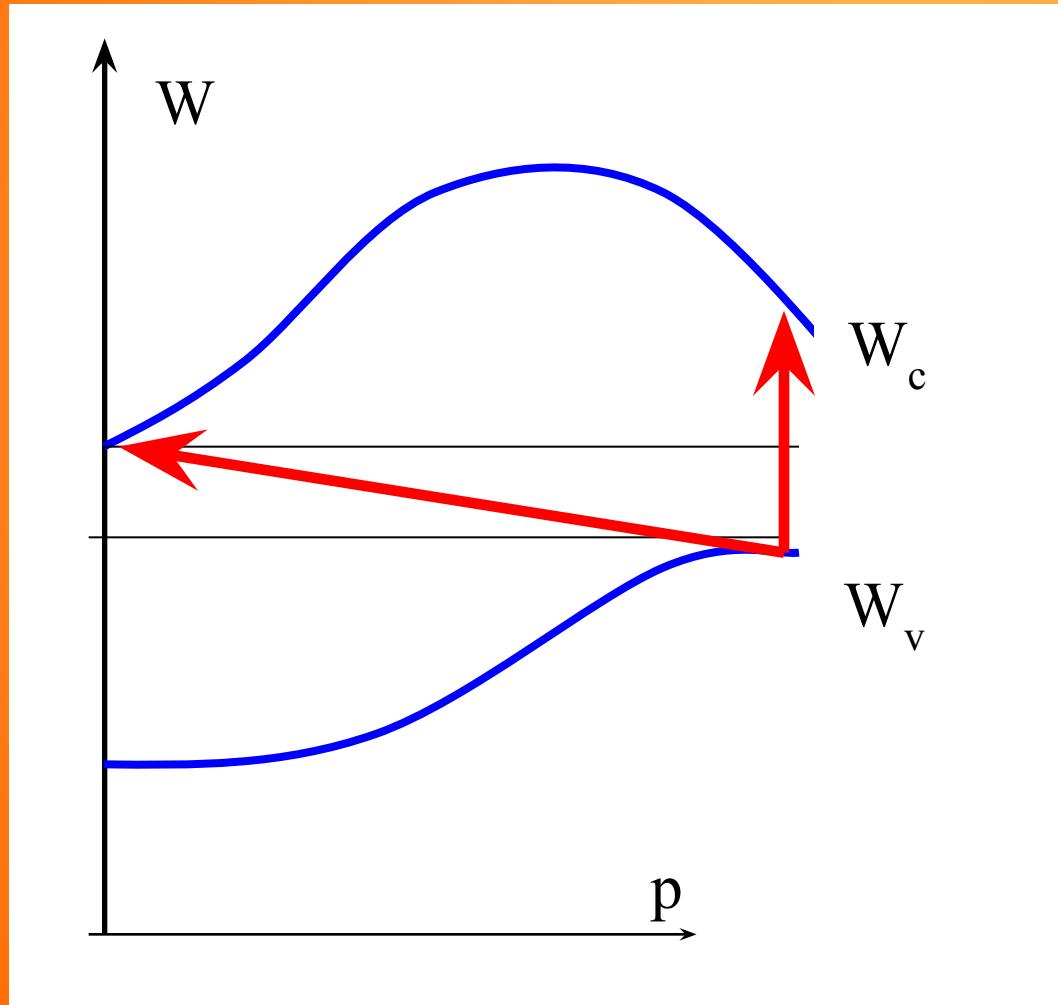


**ЗОНА  
ПРОВОДИМОСТИ**

**ЗАПРЕЩЕННАЯ  
ЗОНА**

**ВАЛЕНТНАЯ  
ЗОНА**

# Прямые и непрямые переходы



# Прямые и непрямые переходы

- |   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| • Германий Ge   | 0,7        | непрямой           |
| • Кремний Si  | 1,1        | непрямой           |
| • Арсенид галлия AsGa   | 1,4        | прямой             |
| • Сульфид кадмия CdS  | 2,4        | прямой             |
| • Сульфид цинка ZnS   | 3,7        | прямой             |
| • $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$<br>$x < 0,4$<br>$x > 0,4$ | 1,42- 2,16 | прямой<br>непрямой |
| • алмаз   | 5,4        | непрямой           |

# Примесные полупроводники и диэлектрики

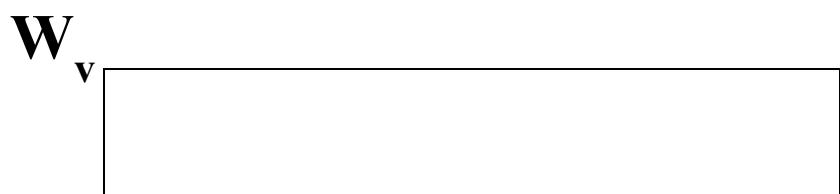
удельное сопротивление  $\rho$  ( $\Omega\text{м}\cdot\text{см}$ )

Чистый Si  $10^5$

Si с примесью фосфора

1 атом Р на  $10^6$  атомов Si  $2,5$

# Примесные полупроводники и диэлектрики



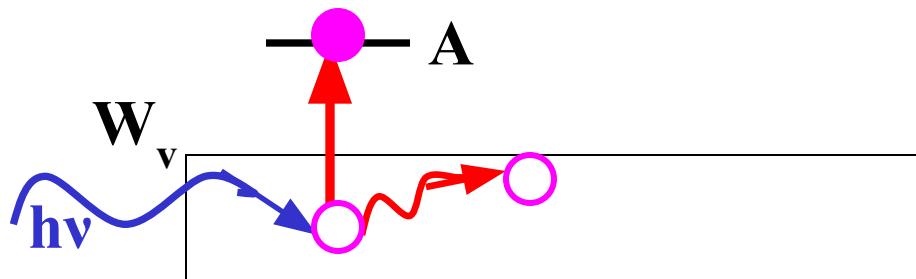
**ЗОНА  
ПРОВОДИМОСТИ**

**ЗАПРЕЩЕННАЯ  
ЗОНА**

**ВАЛЕНТНАЯ  
ЗОНА**

# Примесные полупроводники и диэлектрики

$W_c$  —

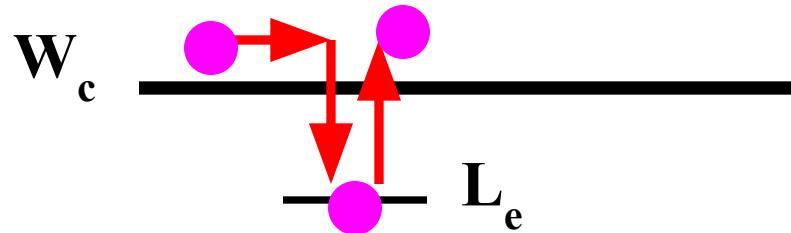


**ЗОНА  
ПРОВОДИМОСТИ**

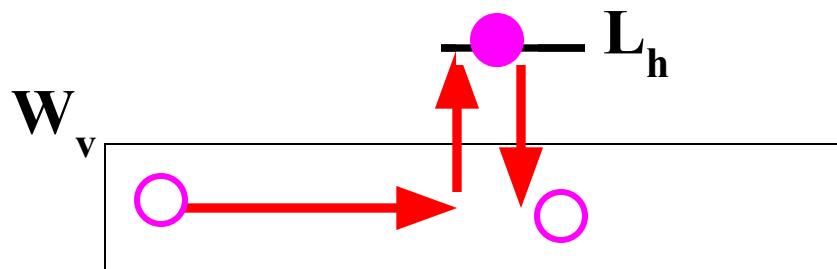
**ЗАПРЕЩЕННАЯ  
ЗОНА**

**ВАЛЕНТНАЯ  
ЗОНА**

# Примесные полупроводники и диэлектрики



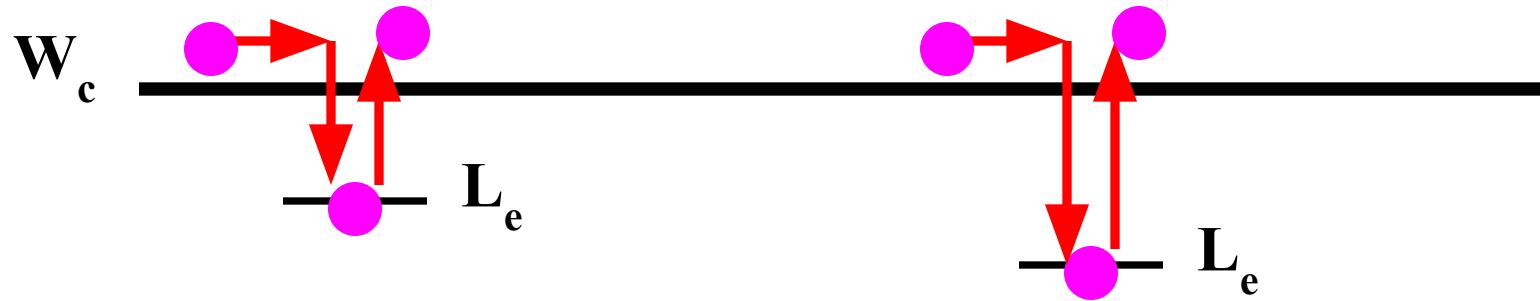
**ЗОНА  
ПРОВОДИМОСТИ**



**ЗАПРЕЩЕННАЯ  
ЗОНА**

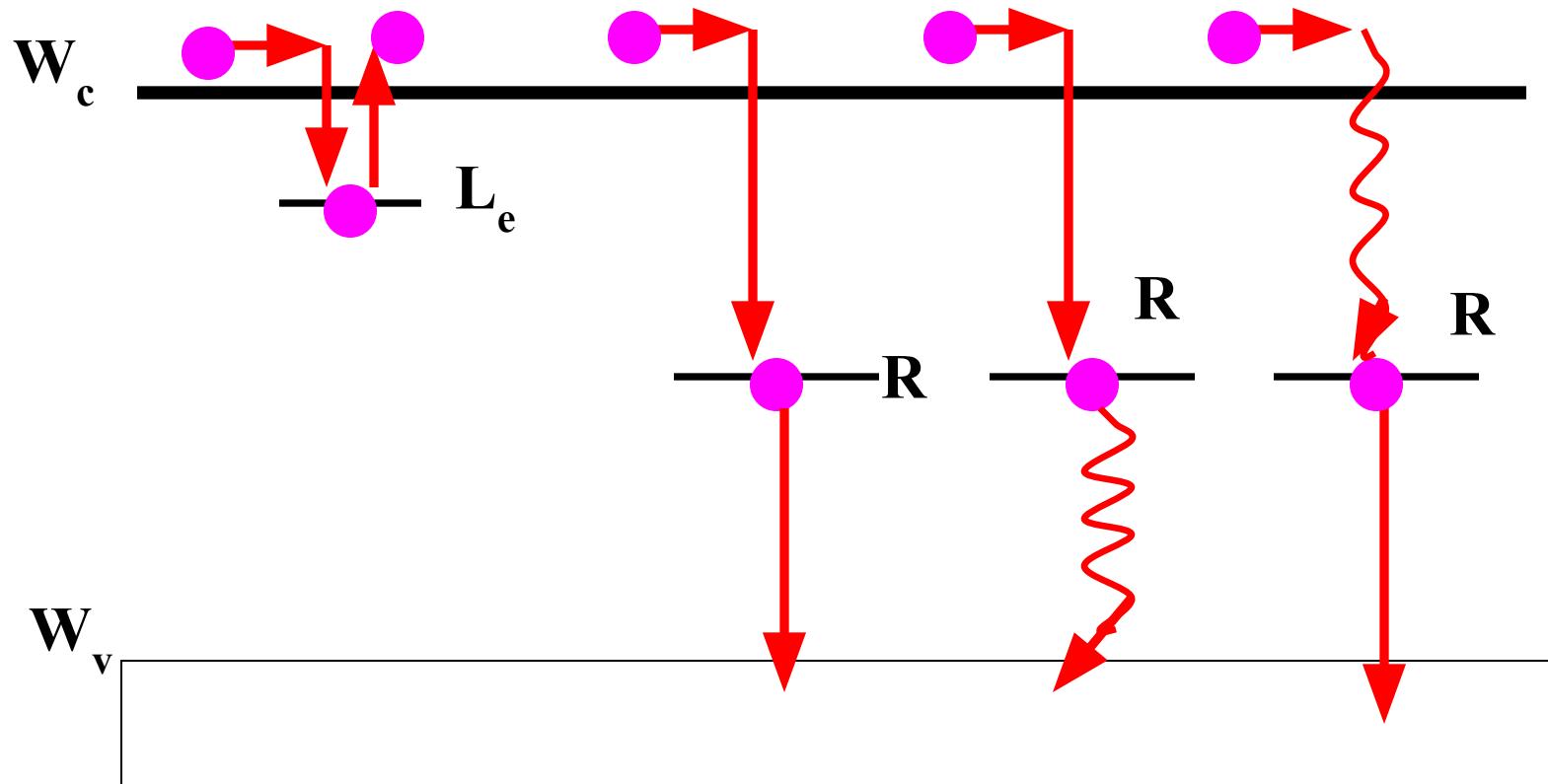
**ВАЛЕНТНАЯ  
ЗОНА**

# Примесные полупроводники и диэлектрики



$W_v$

# Примесные полупроводники и диэлектрики



# Подвижность

$$\mu = V/E$$

$\mu$  - подвижность ( $\text{см}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$ )

$V$  - средняя скорость носителей тока ( $\text{см} \cdot \text{с}^{-1}$ )

$E$  - напряженность электрического поля ( $\text{В} \cdot \text{см}^{-1}$ )

# Электропроводность

$$\sigma = e (\mu_e \cdot n + \mu_h \cdot p)$$

**$\sigma$**  - удельная электропроводность полупроводника ( $\text{Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ );

$$\sigma = 1/\rho$$

**$n$**  и  **$p$**  – концентрации электронов и дырок,

**$e$**  – заряд электрона  $1,6 \cdot 10^{-19}$  (Кл) .

# Статистика равновесных носителей тока

## Функции распределения

1. Максвелла-Больцмана  $f_{M-B} = A e^{-W/kT}$

где  $W$ - заданная энергия,

$f$ - вероятность заполнения частицами  
уровня с энергией  $W$ ,

$A$ - константа,

$k$ - постоянная Больцмана,

$T$ - температура

# Статистика равновесных носителей тока

## Функции распределения

2. Ферми-Дирака

$$f_{F-D} = \frac{1}{e^{\frac{W-W_F}{kT}} + 1}$$

где  $W$  - заданная энергия,

$f$  - вероятность заполнения частицами уровня с энергией  $W$ ,

$k$  - постоянная Больцмана,

$T$  - температура,

$W_F$  - энергетический параметр

# Статистика равновесных носителей тока

## Функции распределения

$$3. \text{ Бозе-Эйнштейна} \quad f_{B-E} = \frac{1}{e^{\frac{W-W_B}{kT}} - 1}$$

где  $W$  - заданная энергия,

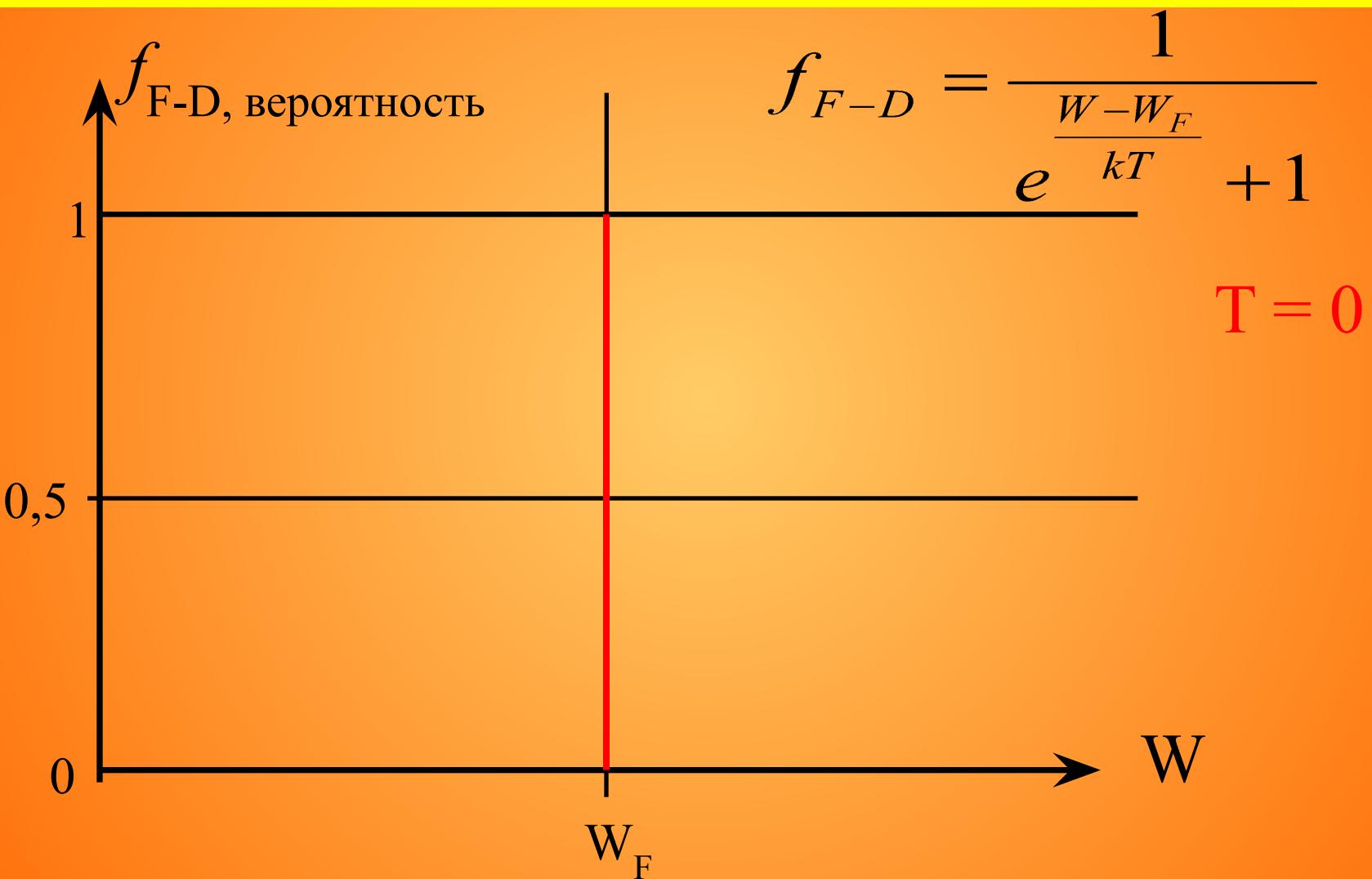
$f$  - вероятность заполнения частицами уровня с энергией  $W$ ,

$k$  - постоянная Больцмана,

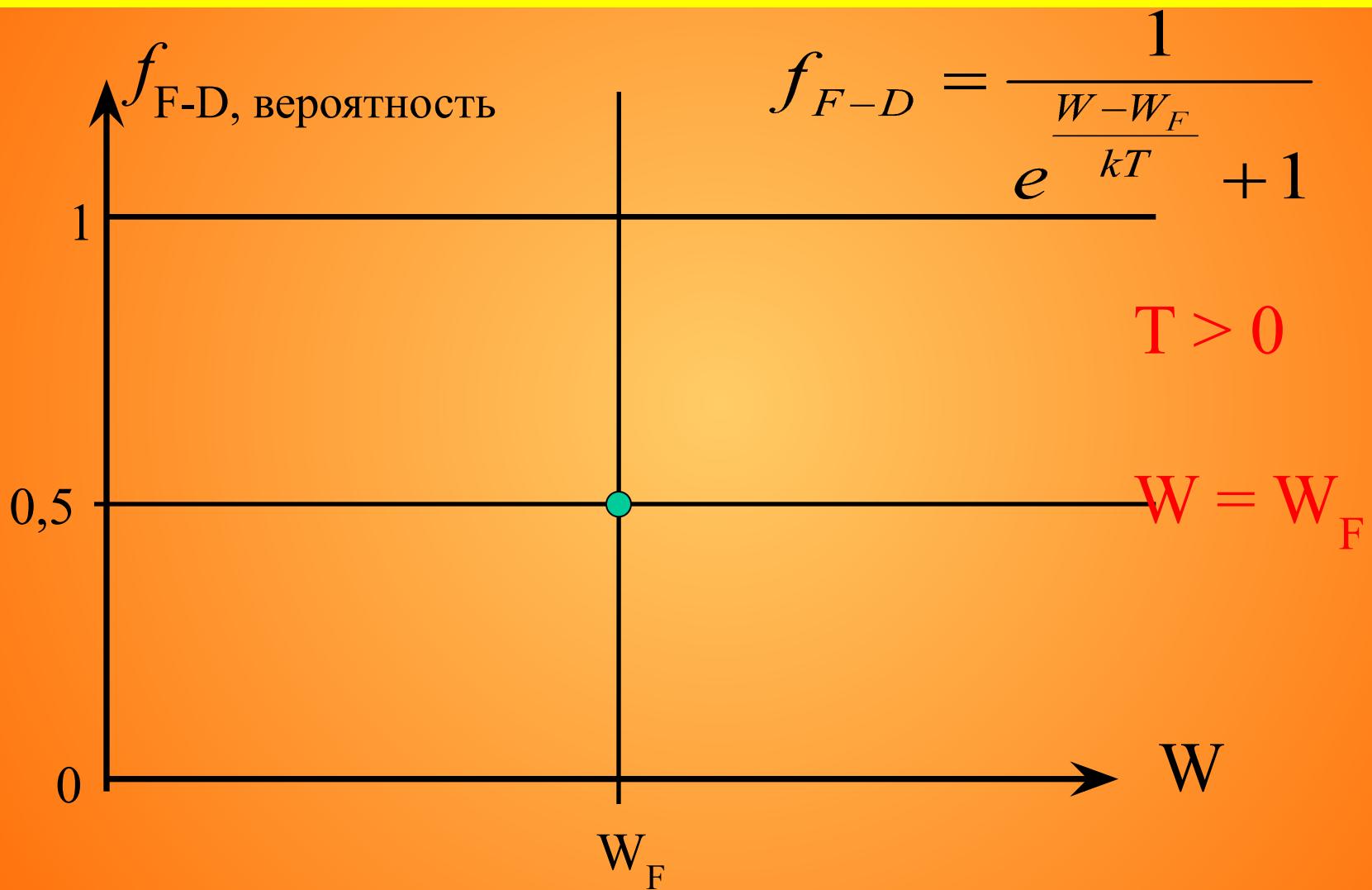
$T$  - температура,

$W_B$  - энергетический параметр

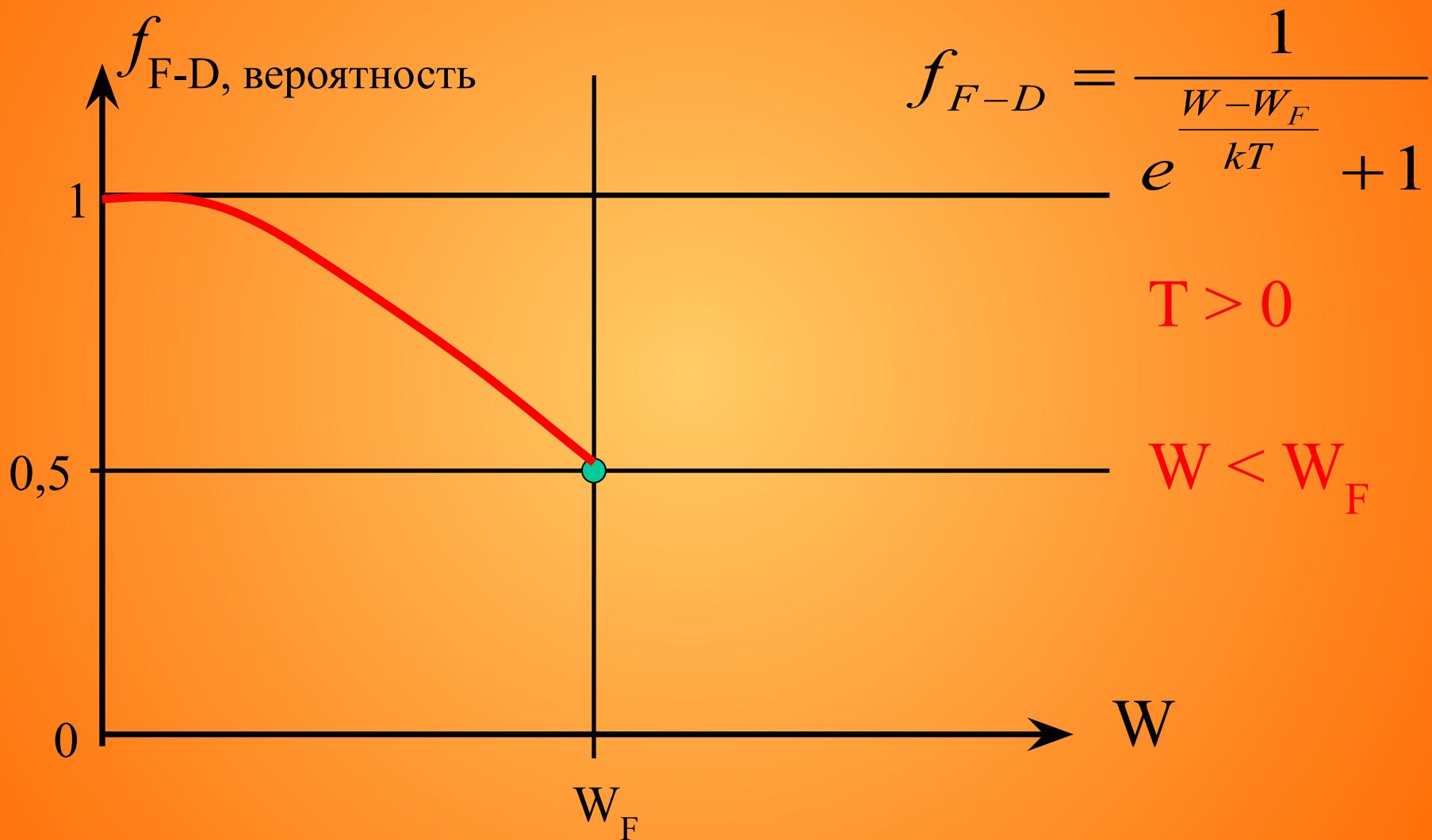
# Функция Ферми-Дирака



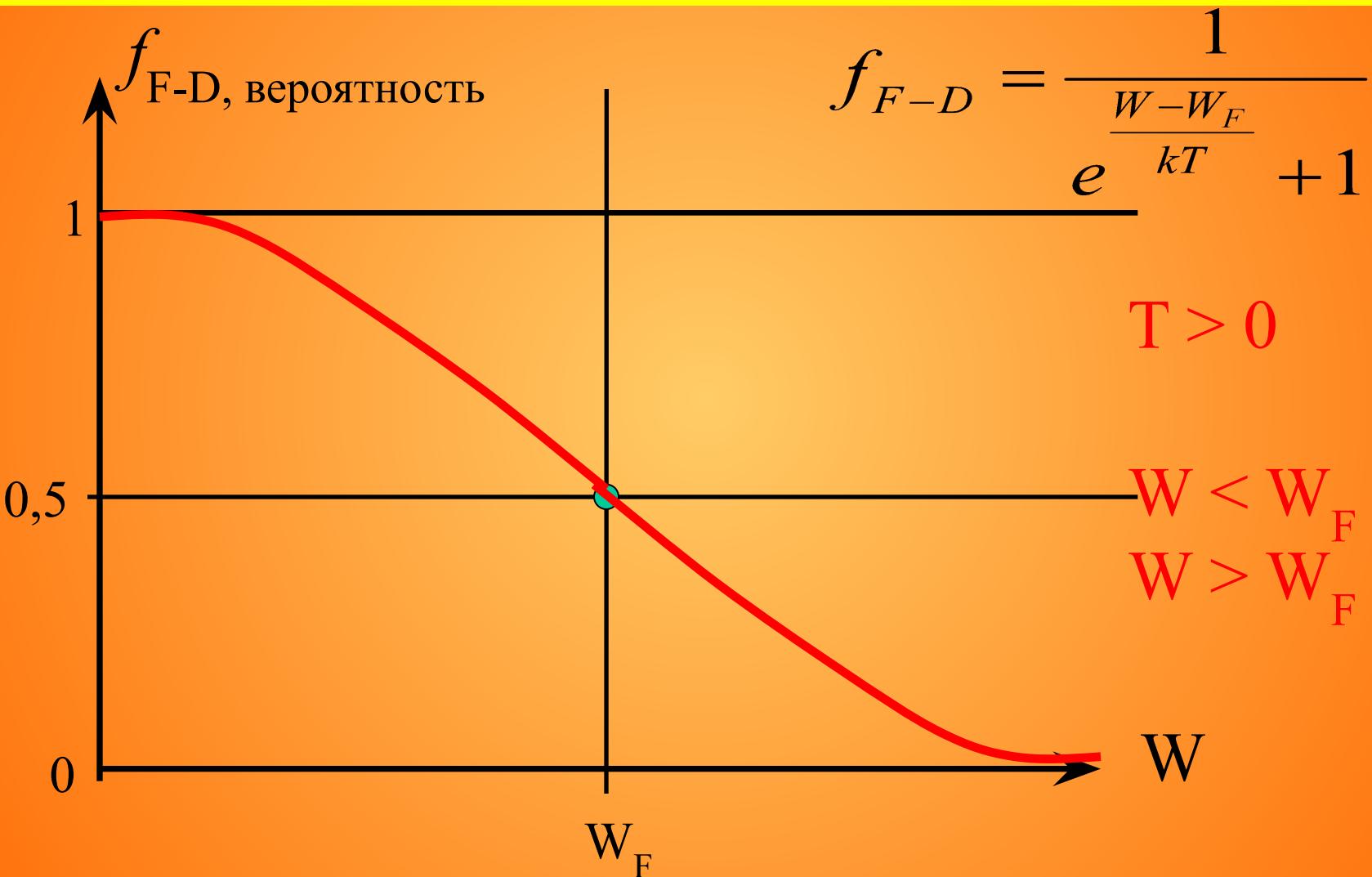
# Функция Ферми-Дирака



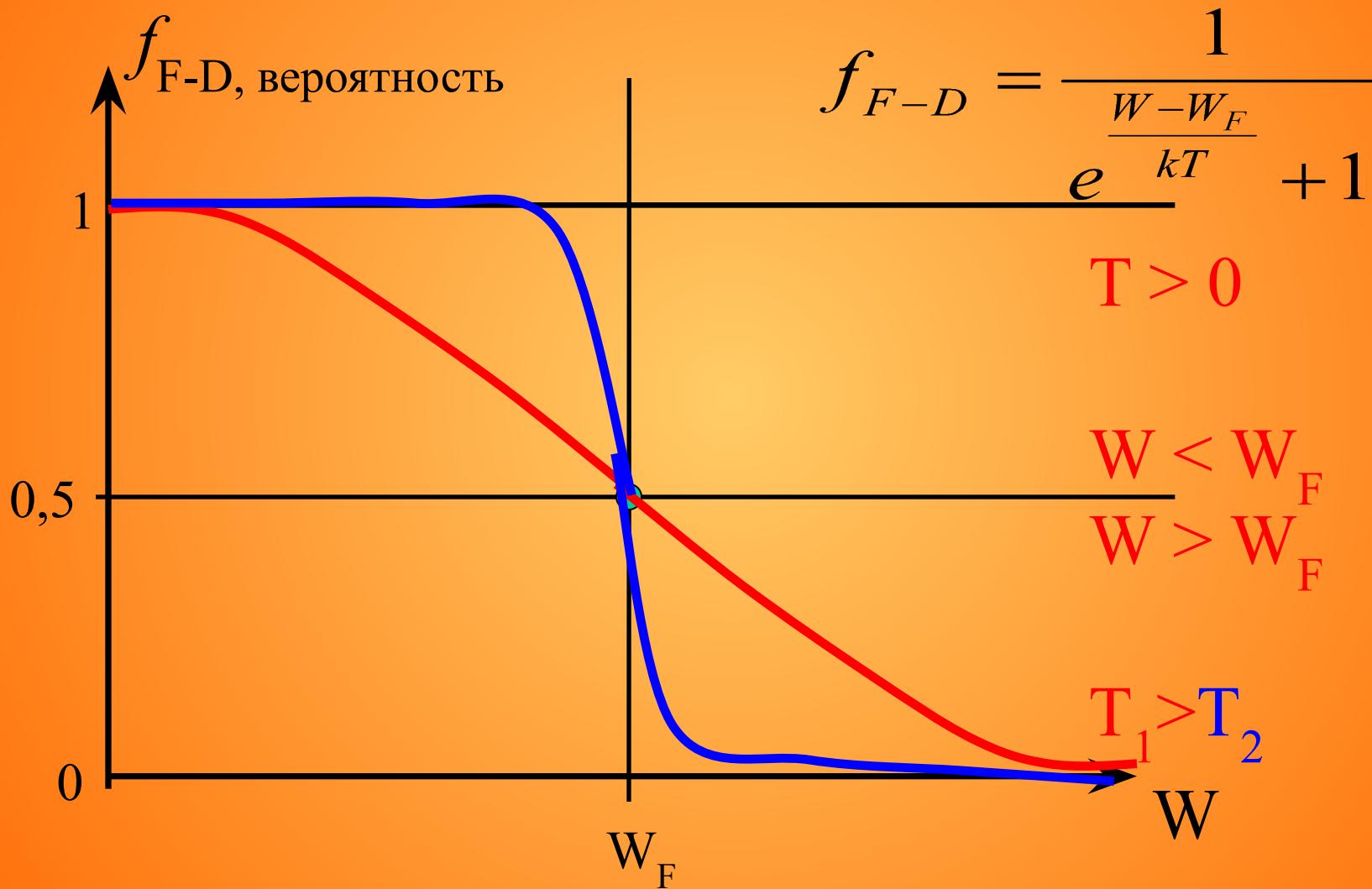
# Функция Ферми-Дирака



# Функция Ферми-Дирака



# Функция Ферми-Дирака



# Функция Ферми-Дирака

$$|W| \gg |W_F|$$

$$f_{F-D} = \frac{1}{e^{\frac{W-W_F}{kT}} + 1} = e^{-\frac{(W-W_F)}{kT}} = e^{W_F/kT} e^{-W/kT}$$

$$f_{F-D} \cong A e^{-\frac{W}{kT}}$$

$W - W_F \geq \pm 2kT$

# Некоторые полезные величины

$$kT = 0,026 \text{ эВ} \quad \text{при } T=300 \text{ К}$$

Значения постоянной Больцмана

$$1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$$

$$8,62 \cdot 10^{-5} \text{ эВ/К}$$

# Функция Ферми-Дирака

$W > W_F$

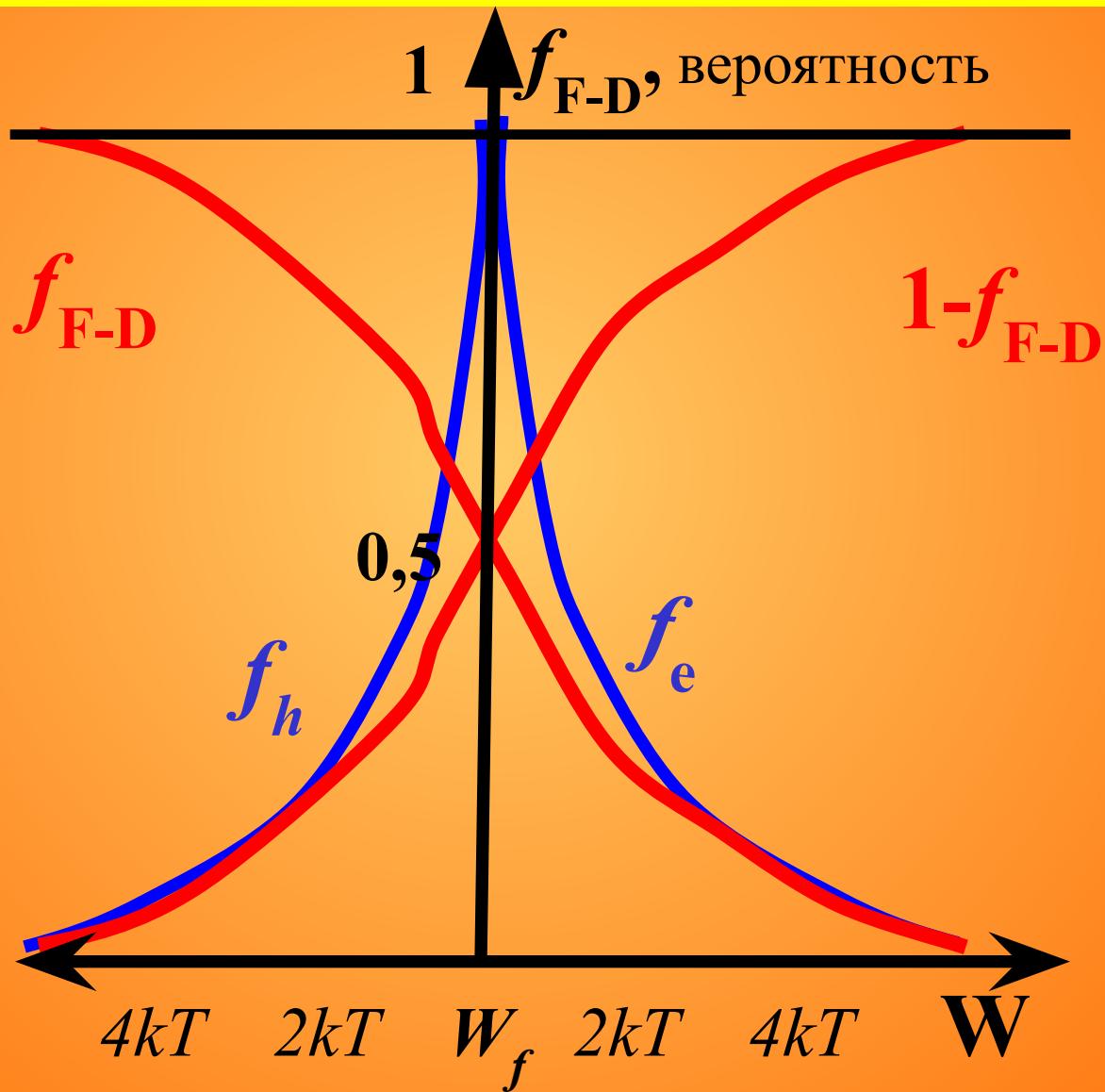
$$f_e = e^{-\frac{(W-W_F)}{kT}}$$

# Функция Ферми-Дирака

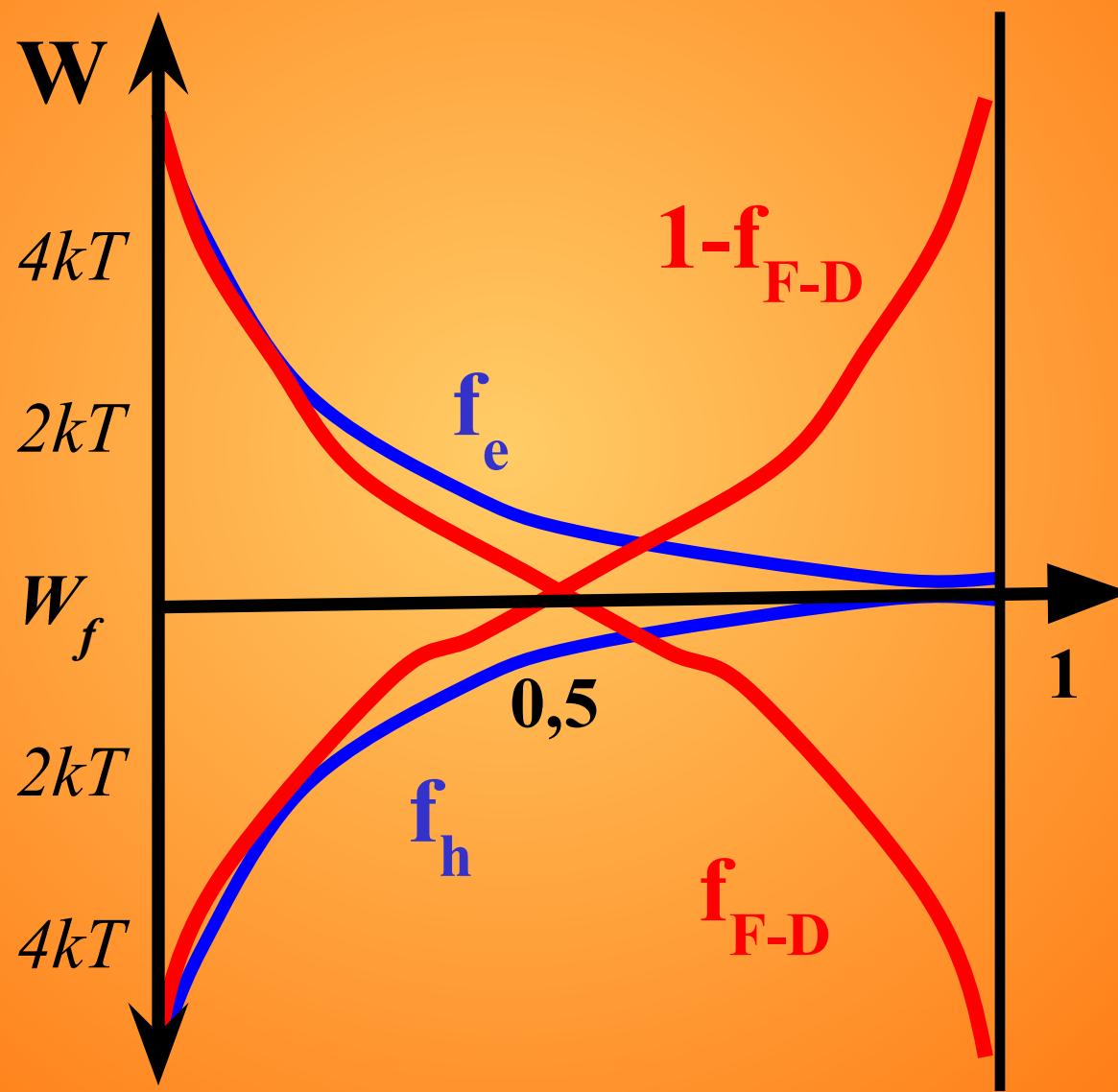
$$W < W_F$$

$$f_h = e^{\frac{W - W_F}{kT}}$$

# Вид функций



# Вид функций



# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

Пусть в кристалле единичного объема в интервале энергий от  $W$  до  $W+dW$  имеется  $dZ$  квантовых состояний.

$$N_W = \frac{dZ}{dW}$$

вероятность заполнения состояния с энергией  $W$  дается функцией  $f_{F-D}$ , концентрация электронов в этих состояниях равна:

$$dn = f_{F-D} dZ = f_{F-D} N_W dW$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$n = \int_{W_1}^{W_2} f_{F-D} N_W dW$$
$$N_{WC} = 4\pi \cdot \left( \frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} (W - W_C)^{1/2}$$

$N_{WC}$  – функция плотности состояний

$m^*$  - эффективная масса электронов в зоне проводимости,

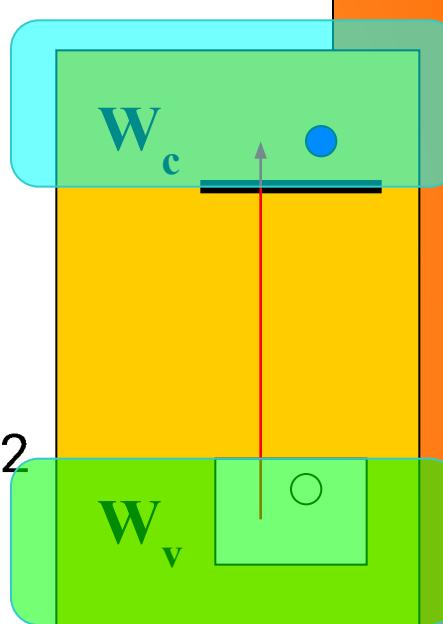
$h$  - постоянная Планка,

$W_C$  - энергия дна зоны проводимости.

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$N_{WC} = 4\pi \cdot \left( \frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} (W - W_C)^{1/2}$$

$$N_{WV} = 4\pi \cdot \left( \frac{2m_h^*}{h^2} \right)^{3/2} (W_V - W)^{1/2}$$



$m_e^*$ - эффективная масса электронов в зоне проводимости,

$m_h^*$ - эффективная масса дырок в валентной зоне,

$h$  - постоянная Планка,

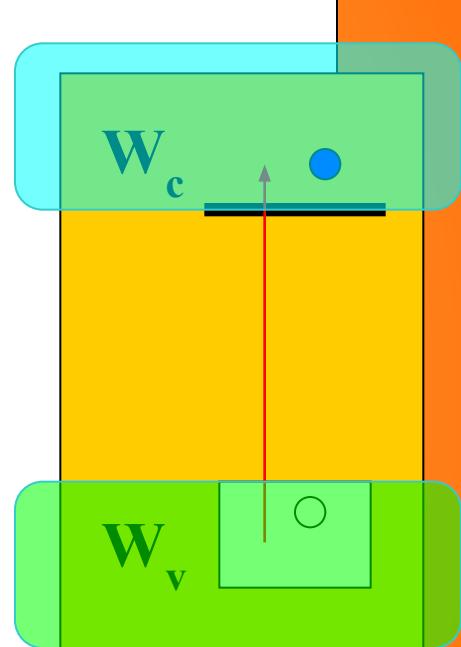
$W_C$ - энергия дна зоны проводимости

$W_V$ - энергия потолка валентной зоны

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$n = \int_{W_1}^{W_2} f_{F-D} N_W dW$$

$$n = N_c \cdot f_e(W_c)$$



$N_c$  - эффективная плотность состояний

$f_e(W_c)$  - значение функций распределения  
для энергии  $W=W_c$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$N_C f_e(W_C) = \int_{W_C}^{\infty} f_{F-D} N_W dW$$

При условии  $W_C - W_F \geq 2kT$ .

$$N_C \cdot e^{-\frac{W_C - W_F}{kT}} = 4\pi \int_{W_C}^{\infty} e^{-\frac{(W - W_F)}{kT}} \cdot \left( \frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} \cdot (W - W_C)^{1/2} dW$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$N_C \cdot e^{-\frac{W_C - W_F}{kT}} = 4\pi \int_{W_C}^{\infty} e^{-\frac{(W - W_F)}{kT}} \cdot \left( \frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} \cdot (W - W_C)^{1/2} dW$$

$$N_C = 4\pi \cdot \left( \frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} \int_{W_C}^{\infty} e^{-\frac{(W - W_C)}{kT}} \cdot (W - W_C)^{1/2} dW$$

Интегрируем по частям, как произведение

$$U = (W - W_C) / kT$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$N_C = 4\pi \cdot \left( \frac{2m_e^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2} \int_{W_C}^{\infty} e^{-U} \cdot U^{1/2} dU =$$
$$= 4\pi \cdot \left( \frac{2m_e^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$N_C = 2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot m_e^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$N_C = 2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot m_e^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2} = 5 \cdot 10^{15} \left( \frac{m_e^*}{m} \right)^{3/2} \cdot T^{3/2}$$

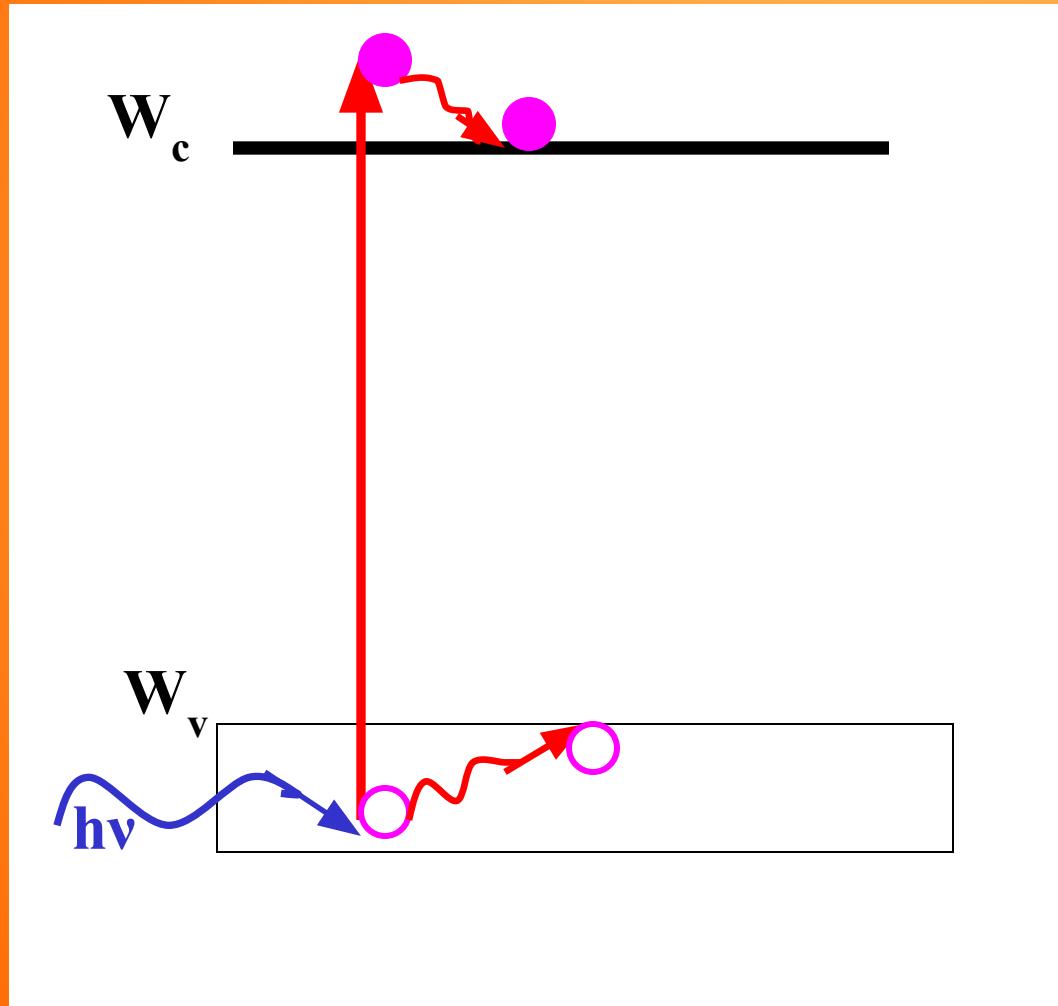
$$N_V = 2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot m_h^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2} = 5 \cdot 10^{15} \left( \frac{m_h^*}{m} \right)^{3/2} \cdot T^{3/2}$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$n = N_C f_e(W_C) = 2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot m_e^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{(W_C - W_F)}{kT}}$$

$$p = N_V f_h(W_V) = 2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot m_h^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{\frac{(W_V - W_F)}{kT}}$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике



$$n = p$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

В собственном полупроводнике  $n = p$

$$2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot m_e^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{(W_C - W_F)}{kT}} = 2 \cdot \left( \frac{2\pi \cdot m_h^* \cdot kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{\frac{W_V - W_F}{kT}};$$

$$\left( m_e^* \right)^{3/2} e^{-\frac{(W_C - W_F)}{kT}} = \left( m_h^* \right)^{3/2} e^{\frac{W_V - W_F}{kT}}$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$\left(m_e^*\right)^{3/2} e^{-\frac{(W_C - W_F)}{kT}} = \left(m_h^*\right)^{3/2} e^{\frac{W_V - W_F}{kT}}$$

$$\frac{-W_C + W_F - W_V + W_F}{kT} = \frac{3}{2} \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$\frac{-W_C + W_F - W_V + W_F}{kT} = \frac{3}{2} \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)$$

$$2W_F - W_C - W_V = \frac{3}{2} kT \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)$$

# Расчет концентраций носителей тока в собственном полупроводнике

$$W_F = \frac{W_C + W_V}{2} + \frac{3kT}{4} \ln \left( \frac{m_h^*}{m_e^*} \right)$$

# Уровень Ферми в собственном полупроводнике

$W_c$  —————

$W_F$  —————

$W_v$  

$$W_F \approx \frac{W_g}{2}$$

# Соотношение носителей тока

$$n_i^2 = n \cdot p = N_c N_v e^{\frac{-W_c + W_F + W_v - W_F}{kT}}$$

$$= N_c N_v e^{\frac{-W_c + W_v}{kT}} = N_c N_v e^{\frac{-W_g}{kT}}$$

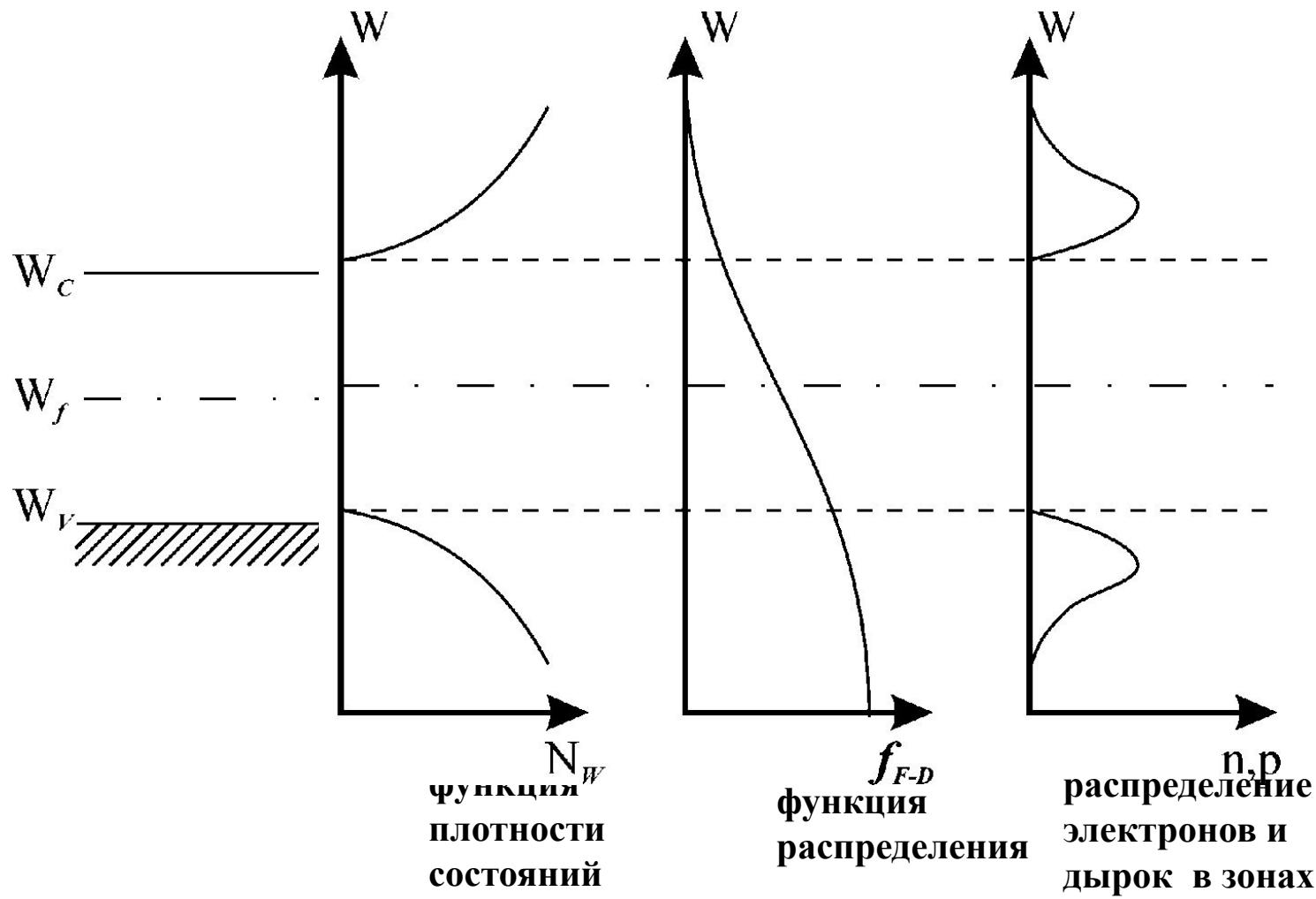
# Соотношение носителей тока

$$n_i = n = p = \sqrt{N_c N_v} \cdot e^{-\frac{W_g}{2kT}}$$

$$n_i = B \cdot T^{3/2} \cdot e^{-\frac{W_g}{2kT}}$$

	$B, \text{K}^{-3/2} \cdot \text{см}^{-3}$	$W_g, \text{эВ}$
Si	$3,84 \cdot 10^{16}$	1,21
Ge	$1,76 \cdot 10^{16}$	0,785

# Концентрации носителей тока в собственном полупроводнике



# **ПРИМЕСНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ**

# Расчет концентраций носителей тока в примесном полупроводнике

$$n_d = \frac{N_d}{\frac{1}{\beta} e^{\frac{W_d - W_F}{kT}} + 1};$$

$n_d$  - концентрация электронов на донорах,

$N_d$  - концентрация доноров,

$W_d$  - энергии донорных (отсчитанные от потока валентной зоны),

$\beta$  - фактор спинового вырождения (от 1 до 2, если доноры могут отдавать кристаллу, а акцепторы принимать от кристалла только по одному электрону; тогда  $\beta=2$ ).

# Расчет концентраций носителей тока в примесном полупроводнике

$$P_d = \frac{N_d}{\beta e^{\frac{W_F - W_d}{kT}} + 1};$$

$p_d$  - концентрация дырок на донорах,

$N_d$  – концентрация доноров,

$W_d$  - энергии донорных (отсчитанные от потока валентной зоны),

$\beta$  - фактор спинового вырождения.

# Расчет концентраций носителей тока в примесном полупроводнике

$$p_a = \frac{N_a}{\frac{1}{\beta} e^{\frac{W_F - W_a}{kT}} + 1};$$

$p_a$  - концентрация дырок на акцепторах,

$N_a$  – концентрация акцепторов,

$W_a$  - энергии акцепторных уровней (отсчитанные от потока валентной зоны),

$\beta$  - фактор спинового вырождения

# Расчет концентраций носителей тока в примесном полупроводнике

$$n_a = \frac{N_a}{\beta e^{\frac{W_a - W_F}{kT}} + 1},$$

$n_a$  - концентрация электронов на акцепторах,

$N_a$  – концентрация акцепторов,

$W_a$  - энергии акцепторных уровней (отсчитанные от потока валентной зоны),

$\beta$  - фактор спинового вырождения

# Допущения

- 1. Уровень Ферми не приближается к рассматриваемым уровням ближе, чем на  $2kT$**
- 2. Электрическая нейтральность полупроводника**

$$n + n_d - p - p_a = N_d - N_a$$

# Расчет

## Чисто примесная проводимость на примере проводника *n*-типа

При низких температурах электроны в зону проводимости поставляют доноры, а генерация из валентной зоны пренебрежимо мала.

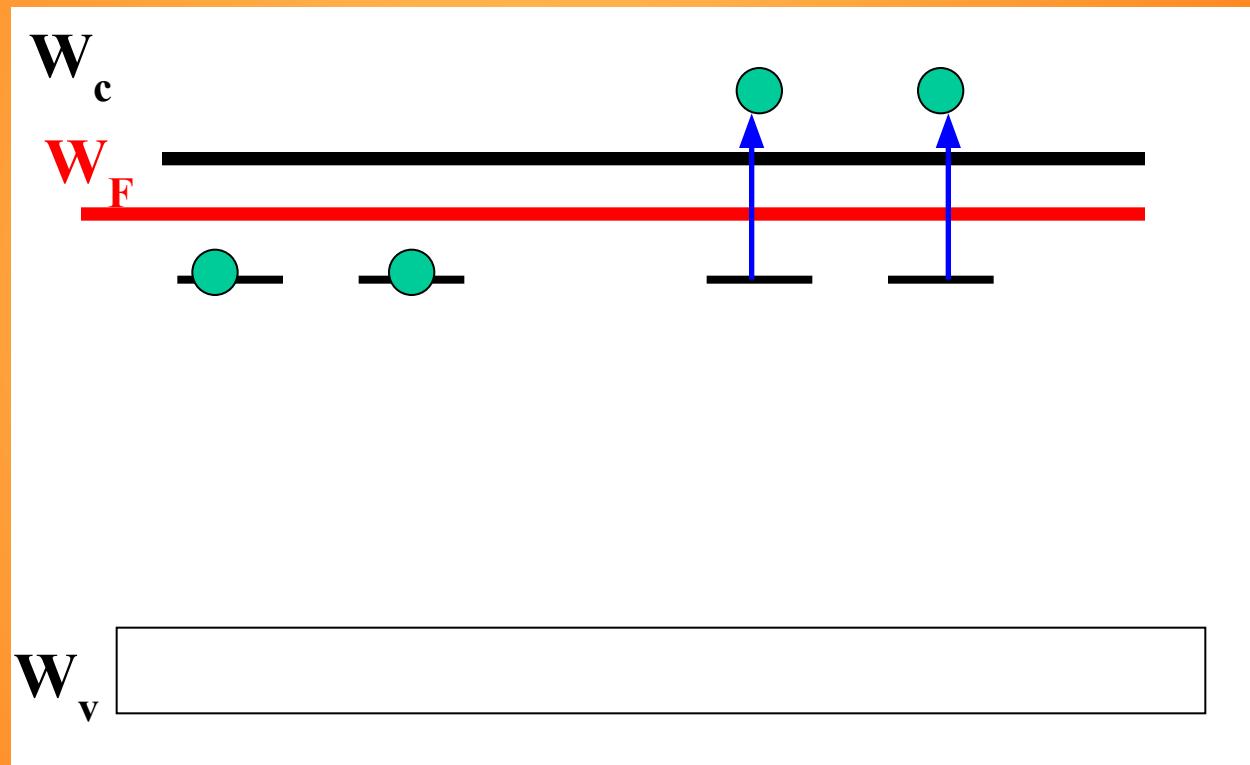
$\Rightarrow N_a, p, p_a$  равны нулю

$$n = N_d - n_d = p_d$$

$$N_C e^{-\frac{(W_C - W_F)}{kT}} = N_d \frac{1}{2} e^{-\frac{(W_F - W_d)}{kT}}$$

$$W_F = \frac{W_d + W_C}{2} + \frac{kT}{2} \ln(\frac{N_d}{2N_C})$$

При  $T=0$  и при  $N_d = 2N_c$  уровень Ферми лежит точно посередине между уровнями доноров и дном зоны проводимости.



В реальных условиях ( $T > 0$  K,  $N_d > 2N_c$ ) он немного сдвинут вверх.

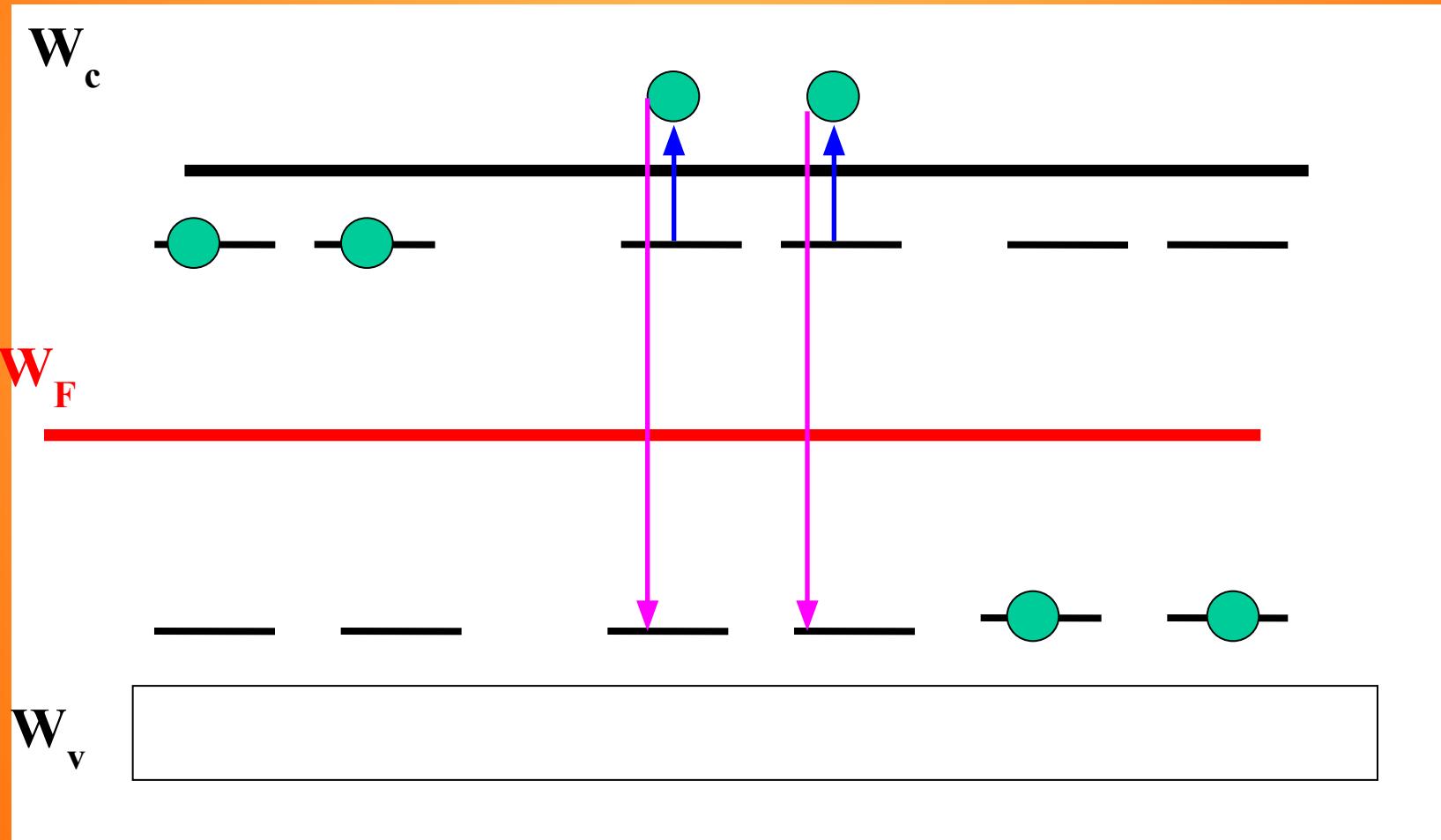
# Компенсированный полупроводник

$$N_d = N_a$$

$$n + n_d - p - p_a = N_d - N_a$$

$$n + n_d - p - p_a = 0$$

$$n_d = 0 \quad p_a = 0 \quad n=p$$



# Частично компенсированный полупроводник

*Примем, что  $N_d = 2 N_a$*

$p_a$  и  $p$  равны нулю. При низкой температуре степень ионизации доноров мала  $\Rightarrow n = 0$

$$n_d = N_d - N_a$$

$$n_d = N_d \cdot f$$

$$f = \frac{N_d - N_a}{N_d} \quad f = 2e^{-\frac{(W_d - W_F)}{kT}}$$

$$\frac{N_d - N_a}{N_d} = 2e^{-\frac{(W_d - W_F)}{kT}}$$

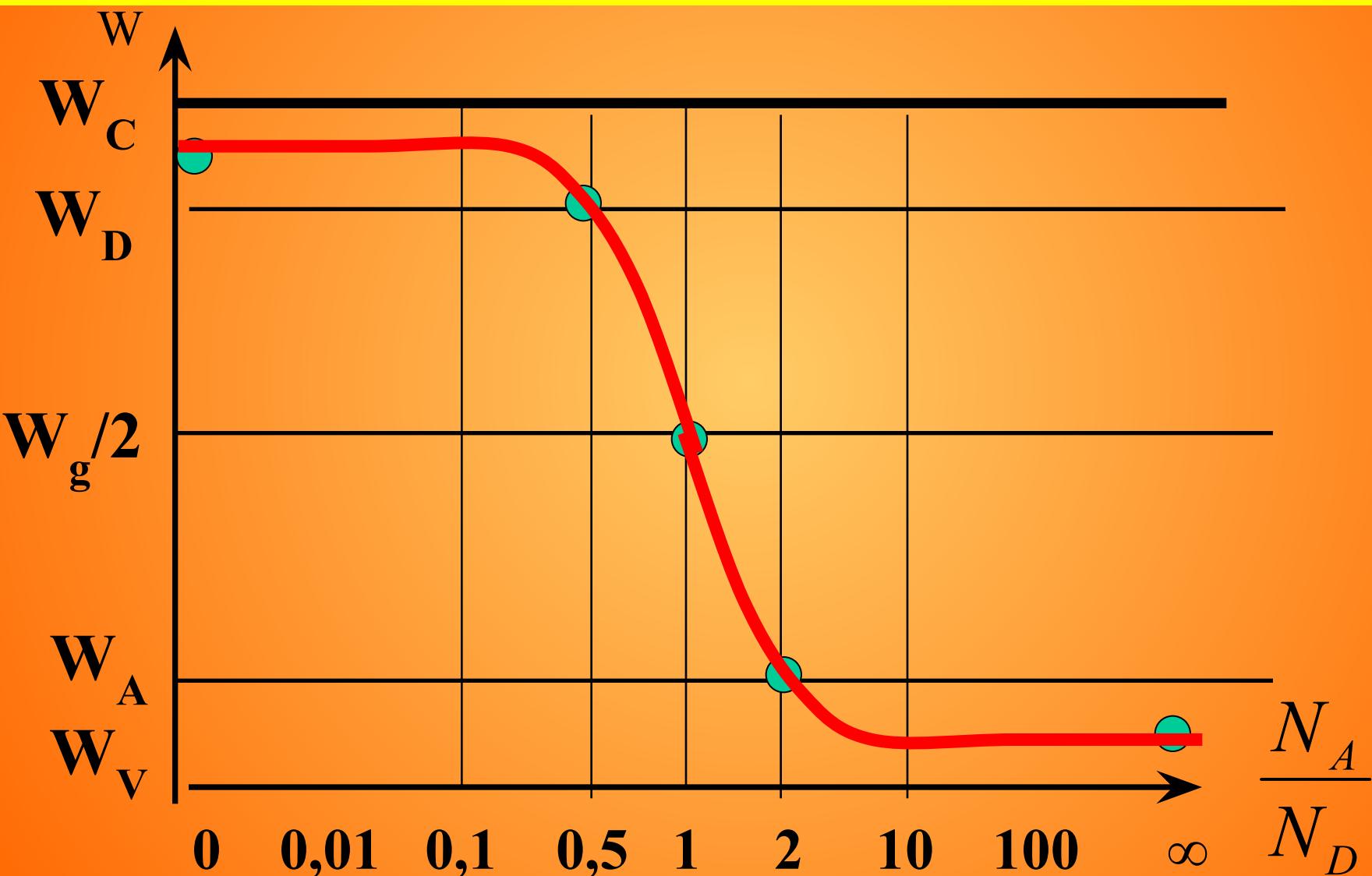
$$\frac{2N_a - N_a}{2N_a} = \frac{1}{2} = 2e^{-\frac{(W_d - W_F)}{kT}}$$

$$W_F = W_d - 1,38kT$$

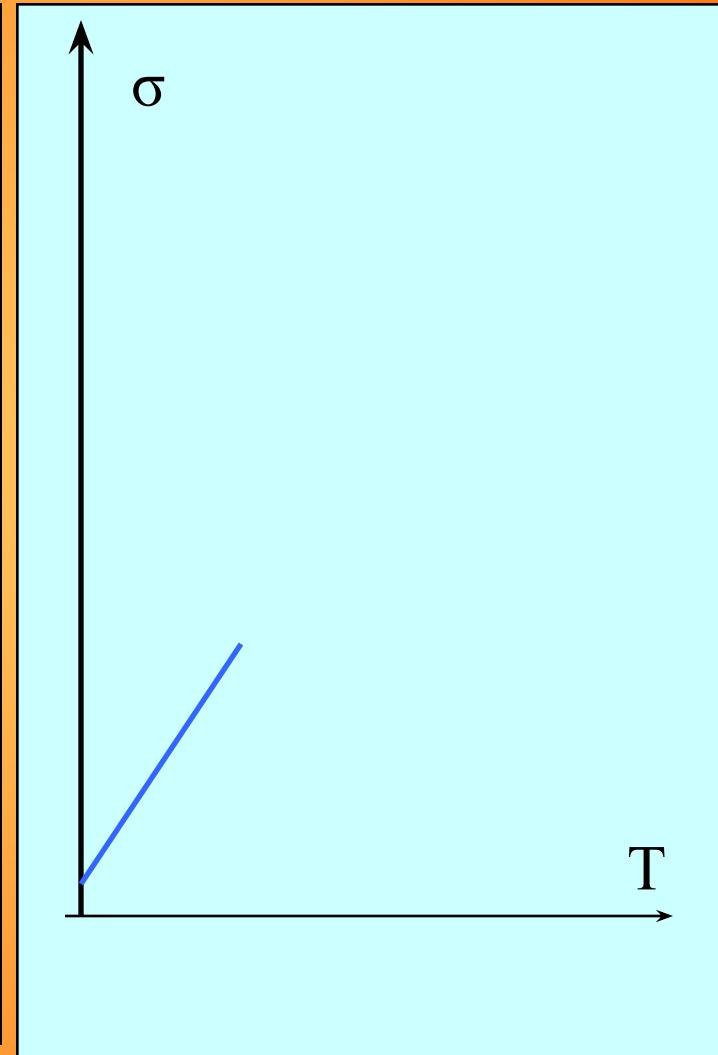
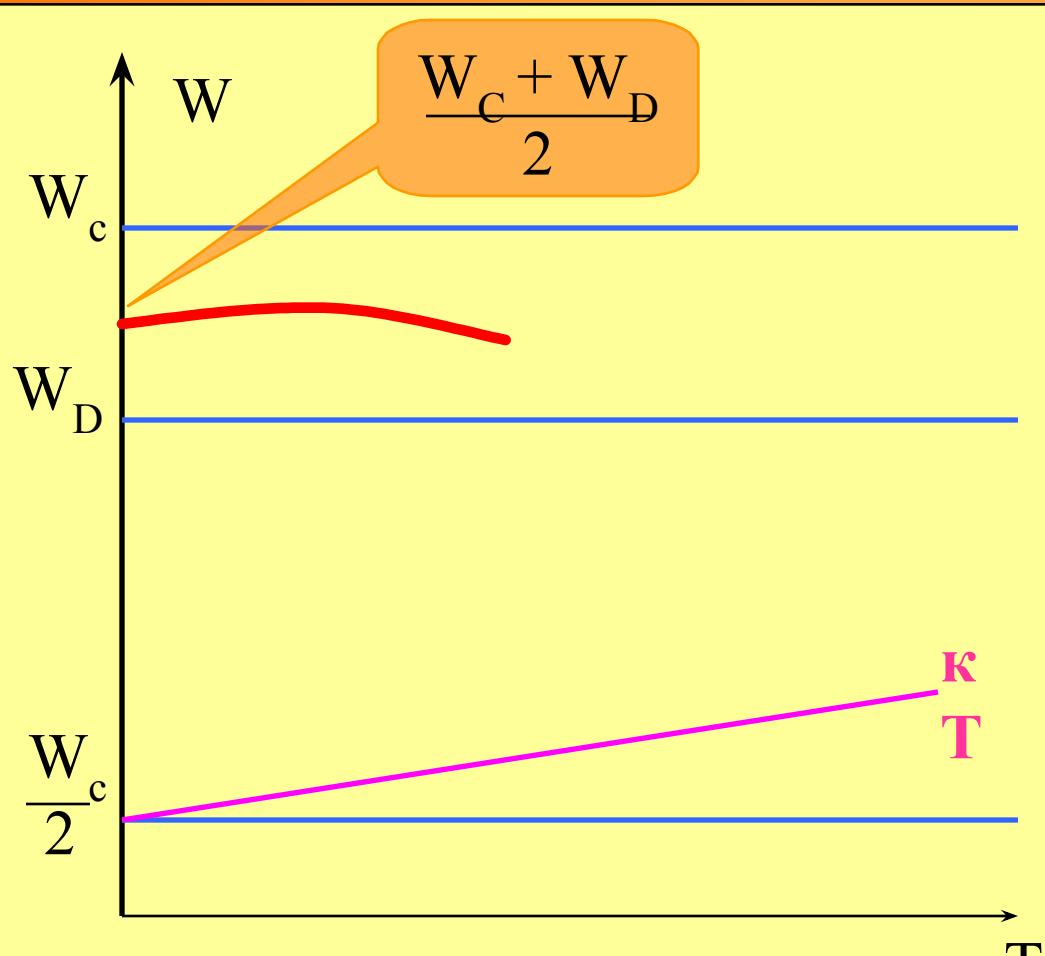
$$W_F = W_d - 1,38kT$$

При  $T=0$ ,  $W_F = W_d$

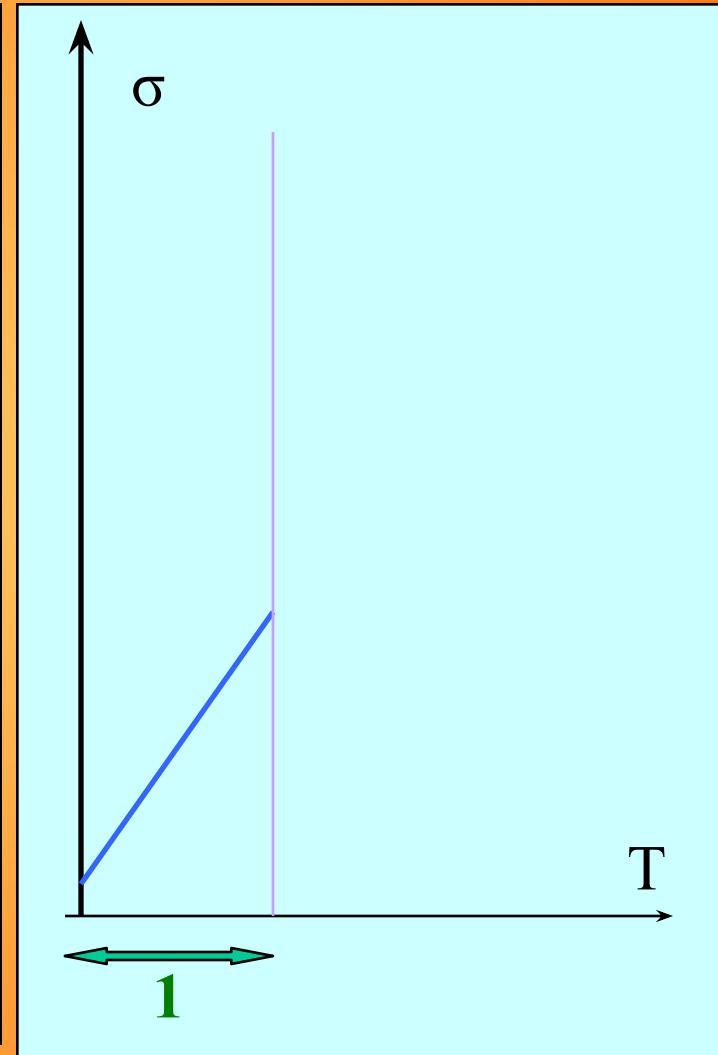
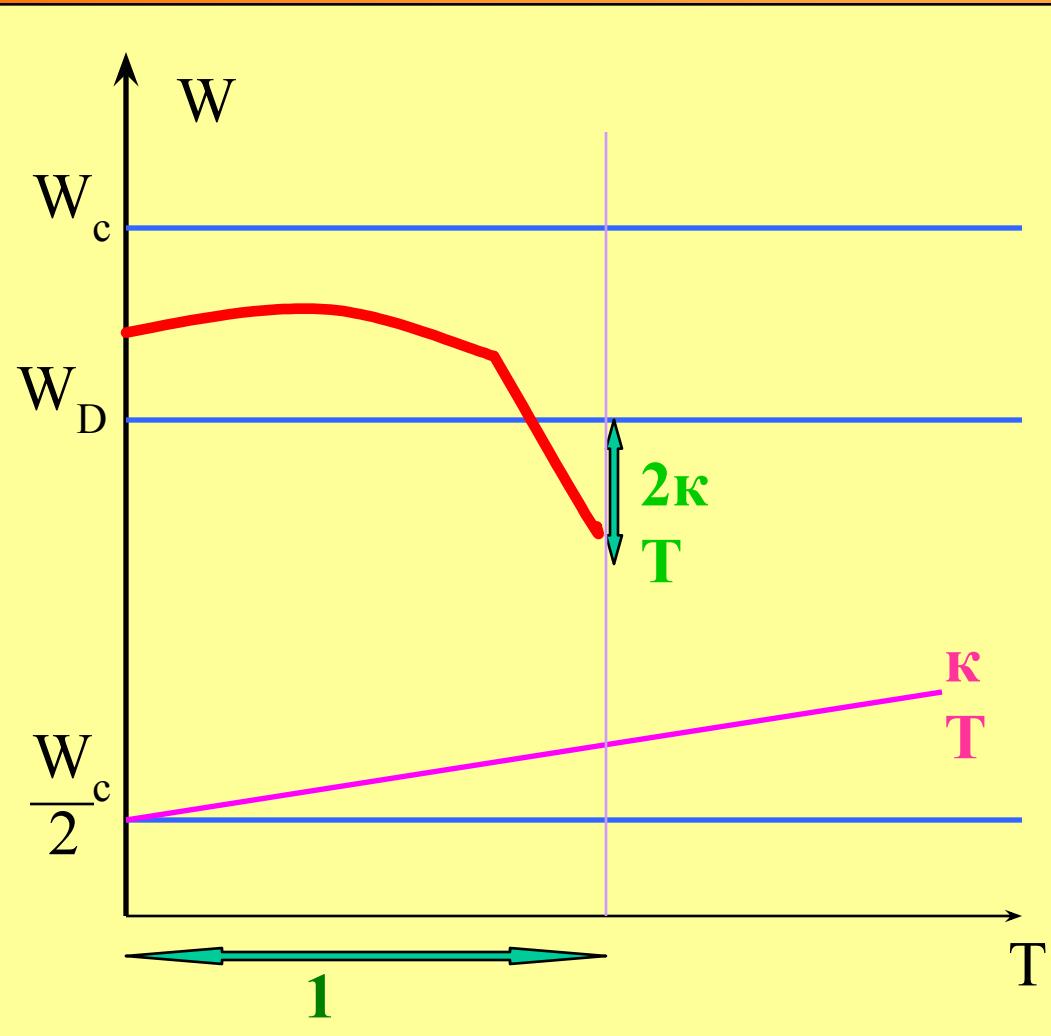
# Положение уровня Ферми



# Температурная зависимость



# Температурная зависимость



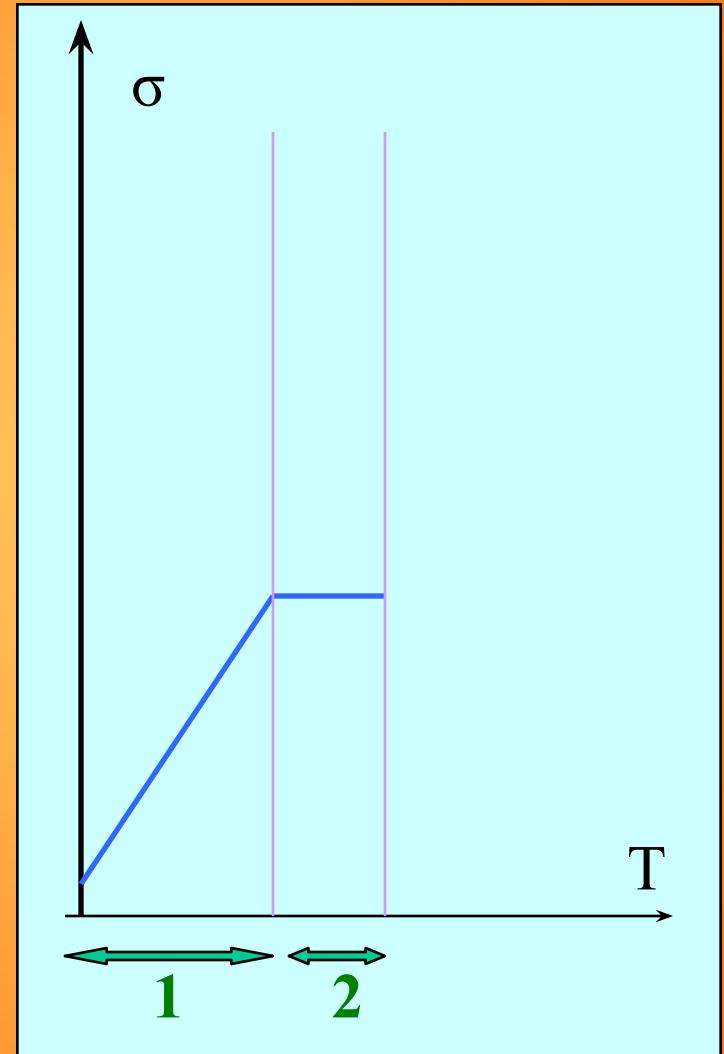
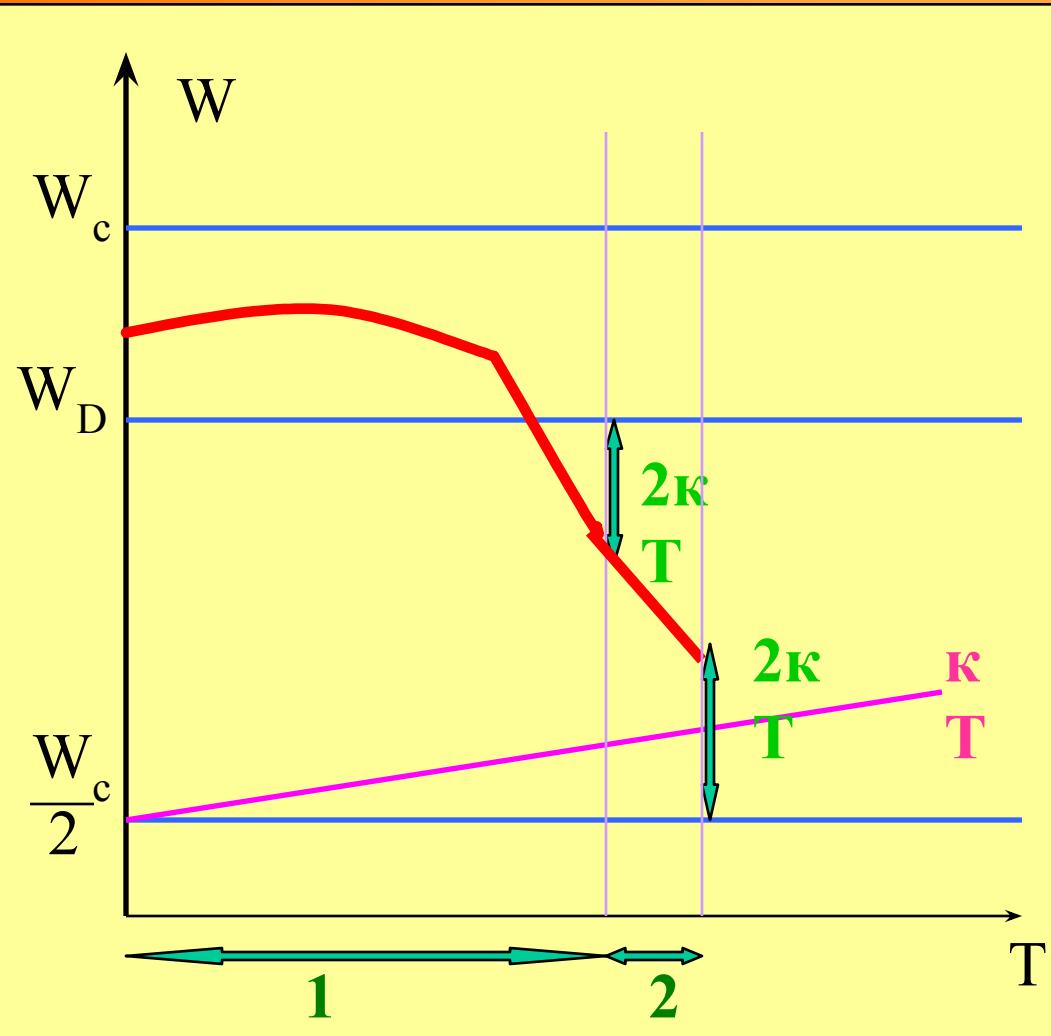
# Температурная зависимость

Температура истощения примеси  $T_s$

$$T_s^D = \frac{W_C - W_D}{k \cdot \ln\left(\frac{2N_C}{N_D}\right)}$$

$$T_s^A = \frac{W_A - W_V}{k \cdot \ln\left(\frac{2N_V}{N_A}\right)}$$

# Температурная зависимость



# Температурная зависимость

Температура ионизации  $T_i$  (переход к собственной проводимости)

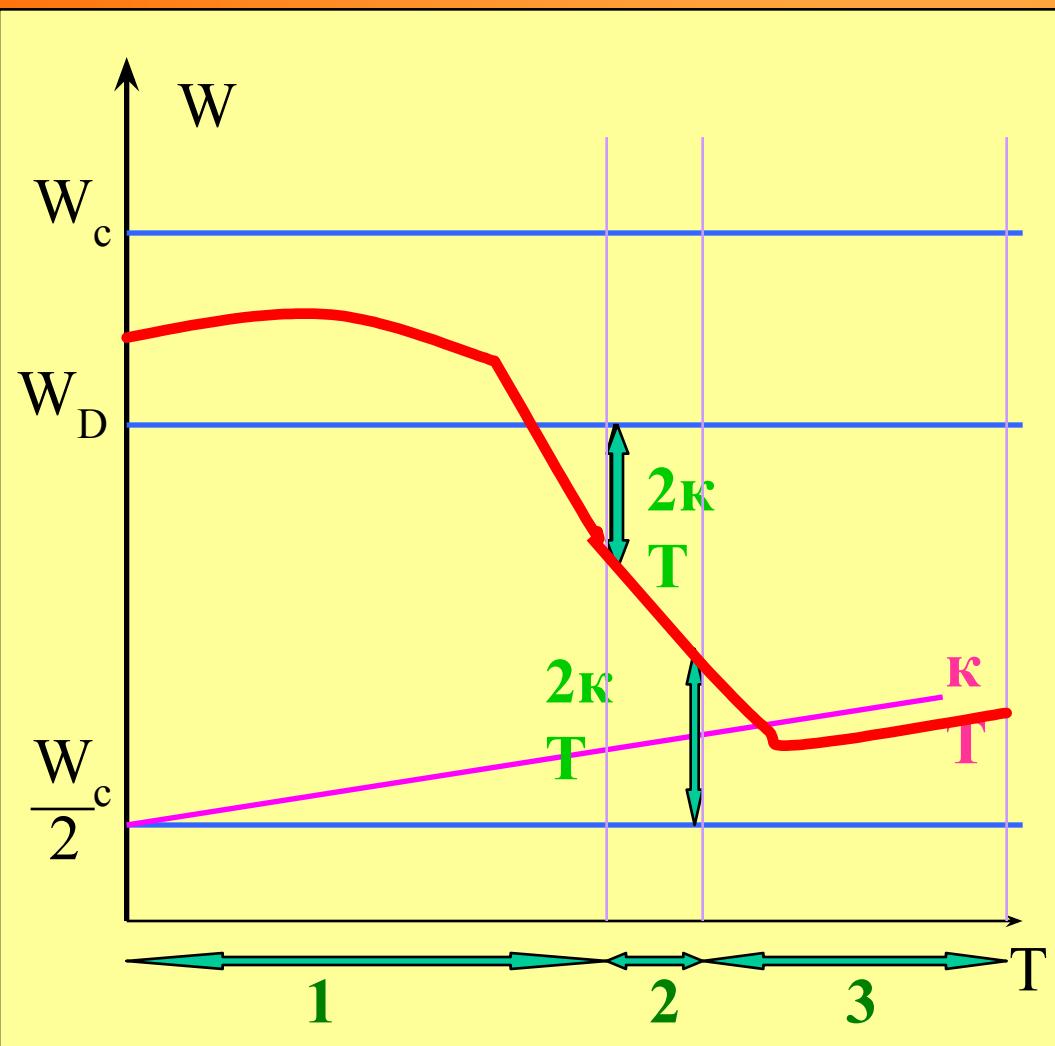
$$T_i = \frac{W_g}{k \cdot \ln(\frac{N_v N_c}{N^2})}$$

$N$  – концентрация примеси

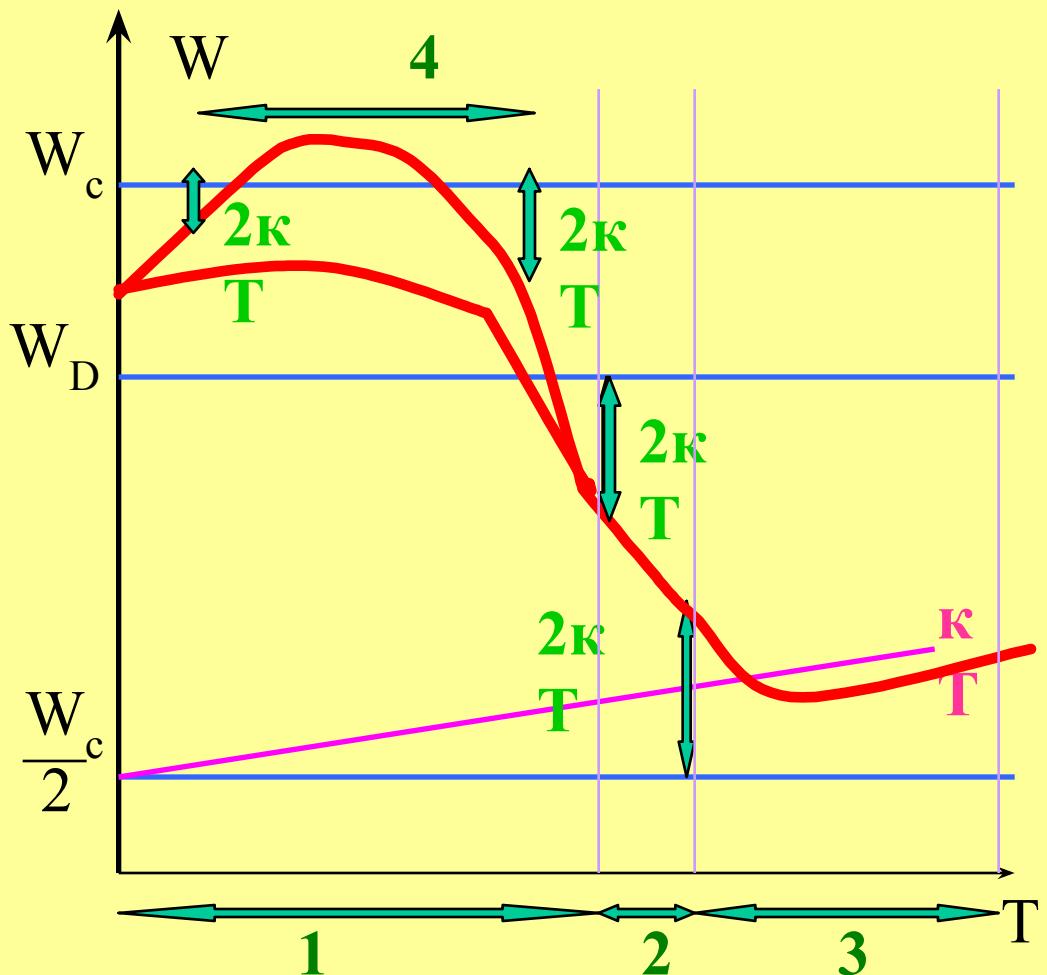
Для Ge, легированного донорной примесью  
 $N_D = 10^{22} \text{ м}^{-3}$  и  $W_D = 0,01 \text{ эВ}$

$$T_s = 32 \text{ K}, \quad T_i = 450 \text{ K}$$

# Температурная зависимость



# Температурная зависимость



$$(W_c - 2kT) \leq W_f$$

$$(W_c - 2kT) \leq W_F \leq (W_c + 2kT)$$

$$n = N_c \frac{1}{e^{\frac{W_F - W_C}{kT}} + 0,25}$$

# Температурная зависимость

